ОБЗОР

PACS 42.55.Ks; 33.50.-j; 82.20.-w

Возбужденные состояния в активных средах кислородно-иодных лазеров

В.Н.Азязов

Дан обзор исследований кинетических процессов в активных средах кислородно-иодных лазеров (КИЛ), проведенных за последнее десятилетие. Рассмотрены механизмы образования и тушения электронно- и колебательно-возбужденных молекул O_2 и I_2 . проанализированы механизмы диссоциации I_2 в активной среде КИЛ. Описаны методы определения концентраций возбужденных частиц в кислородно-иодной среде. Рекомендованы значения кинетических констант процессов, протекающих в активных средах КИЛ.

Ключевые слова: кислородно-иодный лазер, синглетный кислород, диссоциация I_2 , колебательно-возбужденный кислород, $I({}^2P_{1/2})$, $O({}^3P)$, $O({}^1D)$, $O_2(a\,{}^1\!\Delta_g)$, $O_2(b\,{}^1\Sigma_g^+)$, $I_2(A',A)$, $I_2(B)$, N_2O , NO_2 , N_2O_4 , O_3 .

	Содержание
1. Введение	989
2. Особенности кинетических процессов в активной среде ХКИЛ	990
2.1. Регистрация колебательно-возбужденных молекул O_2	
2.2. Образование и релаксация $I_2(v)$	
2.3. Кинетика электронно-возбужденных молекул $I_2(A', A, B)$	
2.4. Каналы диссоциации I_2 в активной среде КИЛ	
3. Кинетика образования и гибели $O_2(a)$ и I^* в активных средах ЭКИЛ и ФКИЛ	999
3.1. Тушение $O_2(a)$ в смеси $O(^3P) - O_2(X) - O_2(a)$	
3.2. Квантовый выход $O_2(a)$ в реакциях $O(^1D)$ с N_2O и $O(^3P,\ ^1D)$ с NO_2	
3.3. Тушение I^* молекулами $O(^3P)$, O_3 , NO_2 , N_2O_4 и N_2O	
4. Заключение	1004
5 Hutenatuna	1005

1. Введение

Лазерные системы, работающие на атомарном иоде, подразделяются по способу возбуждения спин-орбитального перехода $I(^2P_{1/2}) \rightarrow I(^2P_{3/2})$. Инверсия населенностей на переходе $I^* \to I$ достигалась различными способами: фотодиссоциацией иодсодержащих молекул; диссоциацией молекул алкилиодидов электронным ударом; передачей электронной энергии от метастабильных состояний молекул. В 1964 г. Каспер и Пиментел [1] впервые получили инверсную населенность на переходе $I^* \to I$ при импульсном УФ фотолизе алкил- и перфторалкилиодидов CX_3I (X = H, F). Квантовый выход возбужденных атомов I* при УФ фотолизе некоторых иодидов превышает 90 % [2-4], что и предопределило, в основном, бурное развитие фотодиссоционного иодного лазера. Кинетике первичных и вторичных процессов в активной среде этого лазера посвящено большое число работ. Наборы рекомендованных кинетических констант процес-

В.Н.Азязов. Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Россия, 443011 Самара, ул. Ново-Садовая, 221; e-mail: azyazov@fian.smr.ru

Поступил в редакцию 28 ноября 2008 г., после доработки – 3 июля 2009 г.

сов приведены в [5 – 7]. (Далее по тексту: I, I* – атомы иода в состояниях $^2P_{3/2}$ и $^2P_{1/2}$ (E=7603 см $^{-1}$); $O_2(X)$, $O_2(a)$, $O_2(b)$ – молекулы кислорода в электронных состояниях $X^3\Sigma_g^-$, $a^1\Delta_g$ (7882 см $^{-1}$), $b^1\Sigma_g^+$ (13121 см $^{-1}$); $I_2(X)$, $I_2(A')$, $I_2(A)$, $I_2(B)$ – молекулы иода в состояниях $X^1\Sigma_g^+$, $A'^3\Pi_{2u}$ (10047 см $^{-1}$), $A^3\Pi_{1u}$ (10847 см $^{-1}$), $B^3\Pi_0$ (15725 см $^{-1}$).)

Метод получения атомов I^* диссоциацией молекул алкилиодидов электронным ударом не нашел широкого применения в первую очередь потому, что квантовый выход I^* в этом процессе составляет около $50\,\%$ [5]. Кроме того, серьезной проблемой являлось получение стабильного разряда в средах, содержащих алкилиодиды.

Спин-орбитальный переход атомарного иода $I^* \to I$ может быть инвертирован также путем передачи энергии атомам I от метастабильных электронно-возбужденных молекул или атомов. Поисковые работы по получению лазерной генерации на переходе $I^* \to I$, инвертируемом в ходе передачи энергии, увенчались успехом только для двух энергонесущих молекул — $O_2(a^{-1}\Delta)$ [8] и $NCl(a^{-1}\Delta)$ [9, 10]. Данные молекулы в синглетном состоянии являются метастабильными — их переход в основное состояние $X^3\Sigma$ запрещен по правилам отбора. Скорости столкновительной дезактивации этих молекул относительно малы, в особенности для гомоядерной молекулы кислорода. Однако они эффективно передают свою энергию возбуждения атомарному иоду в процессах

$$O_2(a^1\Delta) + I \leftrightarrow O_2(X^3\Sigma) + I^* + 280 \text{ cm}^{-1},$$
 (i)

$$NCl(a^{1}\Delta, v = 0) + I \rightarrow NCl(X^{3}\Sigma, v = 2) + I^{*} + 50 \text{ cm}^{-1}$$
 (ii)

с константами скоростей $K_{\rm i}=7.8\times 10^{-11}~{\rm cm^3/c}$ [11] и $K_{\rm ii}=2\times 10^{-11}~{\rm cm^3/c}$ [12, 13] (v – колебательное квантовое число). Использование процесса (ii) для инвертирования лазерного перехода встретило серьезные трудности, основная из которых заключается в сложности и низкой производительности генераторов электронно-возбужденных молекул NCl(a $^1\Delta$).

Одним из перспективных способов инвертирования лазерного перехода $I^* \to I$ является передача энергии атомарному иоду от метастабильного электронно-возбужденного состояния кислорода $O_2(a)$ (процесс (i)). Константа равновесия реакции (i) $K_{\rm eq} = K_{\rm i}^+/K_{\rm i}^- = 0.75 \times$ $\exp{(402/T)}$ [14] определяет пороговое относительное содержание электронно-возбужденных молекул синглетного кислорода $\eta_{\Delta} = [O_2(a)]/[O_2]$, при превышении которого газовая среда, содержащая синглетный кислород и иод, способна усиливать свет: $\eta_{\Delta}^{\text{th}} = (1 + 2K_{\text{eq}})^{-1}$. Здесь $K_{\rm i}^{\,+}, \; K_{\rm i}^{\,-} \;$ – константы скорости реакции (i) в прямом и обратном направлениях соответственно; $[O_2] = [O_2(a)] +$ $[O_2(X)]; [O_2(X)], [O_2(a)]$ – концентрация кислорода в основном и синглетном электронных состояниях соответственно. Пороговое содержание О₂(а) при температуре газовой смеси T = 300 K составляет 15%. Впечатляющий прогресс в развитии кислородно-иодных лазеров обусловлен в первую очередь наличием высокопроизводительных генераторов синглетного кислорода (ГСК). Существует множество способов получения синглетного кислорода [15, 16]. Отметим только те из них, которые нашли применение в действующих кислородно-иодных лазерах (КИЛ), - фотолизный, электроразрядный и химический. В зависимости от типа используемого генератора в литературе закрепились следующие названия кислородно-иодных лазеров: ФКИЛ (фотолизный генератор), ЭКИЛ (электроразрядный) и ХКИЛ (химический).

Наибольший прогресс был достигнут в развитии XKUЛ, где $O_2(a)$ нарабатывается в ходе хлорирования щелочного раствора перекиси водорода. Однако существуют и другие многообещающие направления развития KUЛ, которые не могут быть реализованы в XKUЛ. В частности, в схеме XKUЛ весьма сложно организовать замкнутый цикл. Выброс отработанных газов в атмосферу сопровождается значительными энергозатратами, что снижает общий KПД системы. Токсичные реагенты (Cl_2, I_2, KOH) делают XKUЛ малопривлекательным для широкого использования.

В настоящее время повышенный интерес проявляется к ЭКИЛ, в которых $O_2(a)$ нарабатывается в плазмохимических процессах в смесях, содержащих кислород. В ЭКИЛ реализация замкнутого цикла выглядит выполнимой задачей. Предполагается, что кислород и буферный газ непрерывно циркулируют в замкнутом контуре, а молекулярный иод и тепло отбираются соответственно в ловушке и теплообменнике. Невысокое давление O_2 на выходе электроразрядного ГСК (до 10 Тор) при низком относительном содержании возбужденных молекул синглетного кислорода ($\eta_{\Delta} \approx 15 \% - 20 \%$) пока не позволяет ЭКИЛ успешно конкурировать с ХКИЛ.

Многолетние исследования кинетики активных сред кислородно-иодных лазеров способствовали созданию

непрерывного лазера с мощностью излучения несколько мегаватт [17]. Однако потенциал КИЛ далеко не исчерпан. Недавние исследования кинетики возбужденных состояний частиц в активной среде КИЛ открывают новые направления их дальнейшего развития. Рост интереса к исследованию свойств возбужденных состояний в кислородсодержащих средах обусловлен также потребностями физики атмосферы [18, 19], лазерной физики [20], физики плазмы [21, 22], физики горения и взрыва [23], биологии [24] и медицины [25].

Кинетике процессов в среде КИЛ посвящено большое число теоретических и экспериментальных работ [11, 14, 21, 22, 26-84]. Поскольку ХКИЛ долгое время являлся фаворитом среди остальных типов КИЛ, то более активно изучалась кинетика химических лазеров. Анализ скоростей процессов в активной среде ХКИЛ и методов их измерения проведен в [54]. В [11] представлена наиболее полная кинетическая схема процессов в среде химического лазера, получившая название стандартный кинетический пакет (СКП) для ХКИЛ, который использовался в моделировании кинетики лазерной среды более десяти лет. За это время были получены новые кинетические данные, существенно изменившие представления о некоторых механизмах образования и дезактивации возбужденных состояний в среде ХКИЛ. Накоплены также обширные кинетические данные по процессам, протекающим в активных средах ФКИЛ и ЭКИЛ. В настоящем обзоре приводятся новые кинетические данные, а также анализируются механизмы образования и тушения электронно- и колебательно-возбужденных состояний в кислородно-иодной среде.

2. Особенности кинетических процессов в активной среде XКИЛ

Инверсия на лазерном переходе $I^* \to I$, создаваемая в ходе передачи электронной энергии от синглетного кислорода атомарному иоду, впервые была получена с использованием химического ГСК, где $O_2(a)$ генерировался при взаимодействии CISO₃F со щелочным раствором перекиси водорода [43]. Первый КИЛ (мощность излучения 4 мВт) был запущен с газожидкостным генератором, в котором газообразный Cl_2 барботировался через слой раствора $H_2O - H_2O_2 - NaOH$ [8]. Способ получения $O_2(a)$ путем хлорирования щелочного раствора перекиси водорода оказался самым производительным и используется в большинстве действующих ХКИЛ.

При контакте поверхности раствора с газом молекулы Cl_2 проникают через межфазную поверхность в глубь раствора, где в узком приповерхностном слое взаимодействуют с ионами HO_2^- :

$$Cl_2 + HO_2^- \rightarrow HCl + Cl^- + O_2(a).$$

Выход $O_2(a)$ в данной реакции по некоторым данным [44, 45, 85, 86] близок к 100 %. Константа скорости жидкофазной реакции наиболее надежно измерена в реакторе с одиночной ламинарной струей [42]. Образовавшийся в жидкости $O_2(a)$ диффундирует к поверхности и десорбируется в газовую фазу. Для наработки кислорода с высокой степенью электронного возбуждения необходимо, чтобы, во-первых, время пребывания $O_2(a)$ в растворе было много меньше времени его жизни в растворе, равного 2×10^{-6} с [15, 87], и, во-вторых, чтобы выработка

хлора происходила на временах, меньших времени тушения $O_2(a)$ в газофазной реакции пулинга $O_2(a)+O_2(a)\to O_2(b)+O_2(X)$.

Приведенные два условия эффективной работы химического ГСК можно реализовать в ряде газожидкостных аппаратов, широко используемых в химической технологии. В первых КИЛ, в основном, применялся барботажный ГСК [8, 88 – 91], что было обусловлено его простотой и довольно высокой производительностью. На выходе этого генератора высокая степень возбуждения кислорода ($\eta_{\Delta} \geqslant 0.5$) сохраняется вплоть до давлений в несколько торр. В пленочных газожидкостных генераторах газ и жидкость соприкасаются на смоченной жидкостью поверхности (поверхность насадки), представляющей собой трубы или пластины [92]. На основе дискового пленочного генератора O_2 (а) был создан ХКИЛ с мощностью излучения 35 кВт [93].

Одной из актуальных задач при реализации мощных импульсных и непрерывных КИЛ является создание источников О₂(а) высокого давления. В случае импульсного КИЛ это позволит увеличить удельный энергосъем с единицы объема активной среды [94-96]. Для непрерывного КИЛ со сверхзвуковым истечением активной среды рост исходного давления кислорода позволяет увеличить число Маха при сохранении высокой плотности $O_2(a)$ в резонаторе, а также упростить систему выхлопа отработанного газа в атмосферу [47, 97]. В КИЛ на основе химического ГСК высокого давления отпадает необходимость в ловушках паров воды [98, 99]. Струйный ГСК позволяет нарабатывать О₂(а) с концентрациями вплоть до 10^{18} см^{-3} и относительным содержанием нарабатываемого кислорода более 50 % [100]. На основе струйного ГСК запущен КИЛ с выходной мощностью 12 кВт [101].

Недавно с использованием газожидкостного генератора, совмещающего в себе свойства струйного, аэрозольного и дискового генераторов, был запущен ХКИЛ с выходной мощностью излучения 50 кВт [102]. На основе струйно-капельного ГСК разрабатывается ХКИЛ мегаваттной мощности [17]. Совсем недавно [103, 104] был испытан ГСК с вращающимся барботажным слоем при центробежном ускорении около 400g. Данный генератор имеет два важных преимущества: высокий (1.34 ммоль/с) удельный расход хлора через единицу площади над барботажным слоем и низкий (3.7 см³/ммоль) объемный расход раствора на единицу расхода молекулярного хлора.

В импульсных КИЛ для генерации атомарного иода используют диссоциацию перфторалкилиодидов под действием У Φ излучения [51, 94 – 96] или электрического разряда [105]. В непрерывных КИЛ преимущественно используется І2, пары которого подмешиваются в кислородсодержащий газовый поток [8]. Молекулярный иод быстро диссоциирует при взаимодействии с О₂(а) [26-29]. Этот способ привлекателен тем, что не требует затрат внешней энергии. Эмпирически эффективность диссоциации I_2 в КИЛ обычно определяют числом молекул $O_2(a)$, затрачиваемых на диссоциацию одной молекулы I₂. Этот параметр не является постоянным числом, а зависит от условий эксперимента, в основном из-за того, что процесс диссоциации включает в себя несколько стадий. Влияние диссоциации на энергетическую эффективность КИЛ продемонстрировано в недавних работах [52, 106]. В [106] энергетическая эффективность лазера была увеличена с 33 % до 40 % за счет уменьшения числа молекул $O_2(a)$, затрачиваемых на диссоциацию одной молекулы I_2 . В условиях экспериментов [106] на диссоциацию одной молекулы иода тратилось 4.2 молекулы $O_2(a)$ [52].

В зависимости от конструкции узла смешения на диссоциацию одной молекулы I_2 может расходоваться 4-16 молекул $O_2(a)$ [52, 107]. Во избежание потерь $O_2(a)$ на диссоциацию иода рассматриваются схемы КИЛ с внешней наработкой атомов иода химическим [108] или электроразрядным [109–113] способами. Однако к настоящему времени не продемонстрировано действия КИЛ с заметно улучшенными выходными параметрами в схемах с внешней наработкой атомов иода.

Константы скоростей элементарных процессов, представленные в СКП [11], измерены с достаточной точностью за исключением констант процессов, ответственных за диссоциацию І2 (процессы из СКП представлены в табл.1 обычным шрифтом). Ключевым во всех типах КИЛ является обмен электронной энергией между О2 и I (процессы (40) и (41)). (Все рассматриваемые в разд.2 реакции и константы их скоростей представлены в табл.1.) Константа скорости процесса (41) измерялась различными методами в работах [56-61, 114]. Константа скорости K_{40} связана с K_{41} соотношением $K_{40}=0.75K_{41}$ × $\exp(402/T)$ [14]. Температурная зависимость константы скорости передачи энергии от I^* к $O_2(X)$ изучалась в [56] с использованием импульсного лазерного фотолиза смеси $O_2 - I_2$ на длине волны 498 нм. Охлаждение газового потока осуществлялось при его адиабатическом расширении в сверхзвуковом сопле.

Табл.1. Кинетические процессы в активной среде ХКИЛ и их константы скоростей.

Номер реакции	Реакция	Константа скорости* $(T = 300 \text{ K})$		
1	$O_2(a)+O_2(a)\to O_2(b,\upsilon)+O_2(X)^{**}$	2.5×10^{-17}		
2	$O_2(a) + O_2(a) \rightarrow O_2(a) + O_2(X)$	0		
3	$O_2(a) + O_2(a) \rightarrow 2O_2(X, \textit{v})$	1.7×10^{-17}		
4	$O_2(b) + O_2(X) \rightarrow O_2(a) + O_2(X)$	3.9×10^{-17}		
5	$O_2(b) + H_2O \rightarrow O_2(a, \textit{v}) + H_2O$	6.7×10^{-12}		
6	$O_2(b) + Cl_2 \rightarrow O_2(a) + Cl_2$	2.0×10^{-15}		
7	$O_2(b) + H_2O_2 \rightarrow O_2(a) + H_2O_2$	3.3×10^{-13}		
8	$O_2(b) + He \rightarrow O_2(a) + He$	1.0×10^{-17}		
9	$\mathbf{O_2}(b) + \mathbf{CO_2} \rightarrow \mathbf{O_2}(a, \boldsymbol{v}) + \mathbf{CO_2}^{***}$	6.0×10^{-13}		
14	$O_2(a)+O_2(X)\to O_2(X)+O_2(X)$	1.6×10^{-18}		
15	$O_2(a) + H_2O \rightarrow O_2(X) + H_2O$	4.0×10^{-18}		
16	$O_2(a) + Cl_2 \rightarrow O_2(X) + Cl_2$	6.0×10^{-18}		
17	$O_2(a) + H_2O_2 \rightarrow O_2(X) + H_2O_2$	0		
18	$O_2(a) + He \rightarrow O_2(X) + He \\$	8.0×10^{-21}		
21	$I_2(X) + \mathrm{O}_2(b) \to I + I + \mathrm{O}_2(X)$	3.5×10^{-11}		
22	$I_2(X) + O_2(b) \rightarrow I_2(X) + O_2(a)$	2.3×10^{-11}		
24	$I_2(X)+O_2(b)\to I_2(A,A^{\prime})+O_2(X)$	0		
25	$I_2(A,A^{\prime}) + O_2(a) \rightarrow I + I + O_2(X)$	3.0×10^{-11}		
26	$I_2(A,A^{\prime})+O_2(a)\to I_2(B)+O_2(X)$	$< 10^{-12}$		
27	$I_2(B) + M \rightarrow I + I + M \\$	$6.0 \times 10^{-11} \ (M = O_2)$		
28	$I_2(A^{\prime})+O_2(X)\to I_2(X)+O_2(a)$	6.3×10^{-12}		
29.1	$I_2(A^{\prime}) + H_2O \rightarrow I_2 + H_2O$	3.4×10^{-12}		
29.2	$I_2(A^{\prime})+N_2\rightarrow 2I+N_2$	3.5×10^{-14}		
29.3	$I_2(A^{\prime}) + CO_2 \rightarrow I_2 + CO_2$	8.5×10^{-13}		
29.4	$I_2(A^{\prime}) + He \rightarrow 2I + He$	9.4×10^{-15}		
30	$I_2(B) \to I + I$	$6.0 \times 10^5 \text{ c}^{-1}$		
31	$I_2(B) \rightarrow I_2(X) + hv$	$6.0 \times 10^5 \text{ c}^{-1}$		
Продолжение табл.1 см. на след. стр.				

Продолжение табл.1 см. на след. стр.

Пре	одолжение табл.1	
32	$I_2(X) + O_2(a) \rightarrow I_2(X, \textit{v}) + O_2(X)$	$< 5.0 \times 10^{-16}$
33	$I_2(X) + I^* \rightarrow I_2(X, v > 10) + I$	3.8×10^{-11}
34	$I_2(X,\upsilon\geqslant 25)+O_2(a)\to I+I+O_2(X)$	3.0×10^{-10}
35	$I_2(X,\boldsymbol{\upsilon}) + O_2 \to I_2(X,\boldsymbol{\upsilon}-1) + O_2$	$v\times 2.7\times 10^{-12}$
36	$I_2(X,\boldsymbol{\upsilon}) + H_2O \rightarrow I_2(X,\boldsymbol{\upsilon}-1) + H_2O$	$v\times6.0\times10^{-12}$
37	$I_2(X, \boldsymbol{v}) + He \rightarrow I_2(X, \boldsymbol{v} - 1) + He$	$v\times3.9\times10^{-12}$
38	$I_2(X, \boldsymbol{v}) + N_2 \rightarrow I_2(X, \boldsymbol{v} - 1) + N_2$	$v \times 3.4 \times 10^{-12}$
39	$I_2(X, \boldsymbol{\upsilon}) + CO_2 \rightarrow I_2(X, \boldsymbol{\upsilon} - 1) + CO_2$	$v\times6.0\times10^{-12}$
40	$I + O_2(a) \rightarrow I^* + O_2(X)$	7.8×10^{-11}
41	$I^* + O_2(X) \rightarrow I + O_2(a)$	2.7×10^{-11}
42	$I + O_2(a) \rightarrow I + O_2(X)$	1.0×10^{-15}
43	$I^* + O_2(X) \rightarrow I + O_2(X)$	0
44	$I^* + O_2(a) \rightarrow I + O_2(b, v)$	1.1×10^{-13}
45	$I^* + O_2(a) \rightarrow I + O_2(a, v)$	1.1×10^{-13}
46	$I^* + O_2(a) \rightarrow I + O_2(X)$	0
47	$I^* + I \rightarrow I + I$	1.6×10^{-14}
48	$I^* + H_2O \rightarrow I + H_2O$	2.0×10^{-12}
49	$I^* + H_2O_2 \rightarrow I + H_2O_2$	2.5×10^{-11}
50	$I^* + He \rightarrow I + He$	5.0×10^{-18}
51	$I^* + O_2(X) \rightarrow I + O_2(X)$	3.5×10^{-16}
53	$I^* \rightarrow I + hv$	$7.8 c^{-1}$
54	$I^* + Cl_2 \rightarrow ICl + Cl$	5.5×10^{-15}
56	$I^* + ICl \rightarrow I_2 + Cl$	1.5×10^{-11}
57	$I_2 + CI \rightarrow ICI + I$	2.0×10^{-10}
58	$ICl + Cl \rightarrow Cl_2 + I$	8.0×10^{-12}
59	$I + I + I_2(X) \rightarrow I_2(X) + I_2(X)$	$3.6 \times 10^{-30} \text{ cm}^6/\text{c}$
60	$I^* + I + I_2(X) \rightarrow I_2(X) + I_2(X)$ $I^* + I + I_2(X) \rightarrow I_2(B) + I_2(X)$	$< 3.6 \times 10^{-30} \text{ cm}^6/\text{c}$
61	$I + I + He \rightarrow I_2(X) + He$	$3.6 \times 10^{-33} \text{ cm}^6/\text{c}$
62	$I + I + O_2(X) \rightarrow I_2(X) + O_2(X)$	$3.7 \times 10^{-32} \text{ cm}^6/\text{c}$
63	$I^* + I + M \rightarrow I_2(B) + M$	=
70	$\mathbf{O_2}(\mathbf{v}) + \mathbf{O_2} \rightarrow \mathbf{O_2}(\mathbf{v} - 1) + \mathbf{O_2}$	8.2×10^{-19}
71	$\mathbf{O}_2(\mathbf{v}) + \mathbf{G}_2 + \mathbf{G}_2(\mathbf{v} - 1) + \mathbf{G}_2$ $\mathbf{O}_2(\mathbf{v}) + \mathbf{H}_2\mathbf{O} \rightarrow \mathbf{O}_2(\mathbf{v} - 1) + \mathbf{H}_2\mathbf{O}$	8.2×10^{-17}
72	$O_2(v) + H_2 O O_2(v-1) + H_2 O$ $O_2(v) + He \rightarrow O_2(v-1) + He$	0
73	$\mathbf{O_2(v)} + \mathbf{N_2} \rightarrow \mathbf{O_2(v-1)} + \mathbf{N_2}$	0
76	$O_2(X,2) + O_2(X,0) \rightarrow O_2(X,1) + O_2(X,1)$	2.0×10^{-13}
77	$O_2(X,3) + O_2(X,0) \rightarrow O_2(X,2) + O_2(X,1)$	2.6×10^{-13}
78	$O_2(X,4) + O_2(X,0) \rightarrow O_2(X,3) + O_2(X,1)$	2.7×10^{-13}
79	$\mathbf{O_2}(\mathbf{a},1) + \mathbf{CO_2} \rightarrow \mathbf{O_2}(\mathbf{a},0) + \mathbf{CO_2}(\boldsymbol{v})$	1.8×10^{-14}
80	$\mathbf{O_2}(\mathbf{a},2) + \mathbf{CO_2} \rightarrow \mathbf{O_2}(\mathbf{a},1) + \mathbf{CO_2}(\mathbf{v})$	4.4×10^{-14}
81	$O_2(a,3) + CO_2 \rightarrow O_2(a,2) + CO_2(v)$	1.0×10^{-13}
82	$\mathbf{O_2}(\mathbf{b},1) + \mathbf{CO_2} \rightarrow \mathbf{O_2}(\mathbf{b},0) + \mathbf{CO_2}(\boldsymbol{v})$	1.2×10^{-12}
83	$\mathbf{O_2}(\mathbf{b},2) + \mathbf{CO_2} \rightarrow \mathbf{O_2}(\mathbf{b},1) + \mathbf{CO_2}(\mathbf{v})$	1.7×10^{-12}
84	$\mathbf{O_2}(\mathbf{b}, 3) + \mathbf{CO_2} \rightarrow \mathbf{O_2}(\mathbf{b}, 2) + \mathbf{CO_2}(\mathbf{v})$	1.6×10^{-12}
85	$O_2(X,1) + H_2(000) \rightarrow O_2(X,0) + H_2O(010)$	1.7×10^{-12}
89	$O_2(a,1) + O_2(X,0) \rightarrow O_2(X,1) + O_2(a,0)$	5.6×10^{-11}
90	$O_2(a, 1) + O_2(x, 0) \rightarrow O_2(x, 1) + O_2(a, 0)$ $O_2(a, 2) + O_2(x, 0) \rightarrow O_2(x, 2) + O_2(a, 0)$	3.6×10^{-11}
91	$O_2(\mathbf{a}, 2) + O_2(\mathbf{x}, 0) \rightarrow O_2(\mathbf{x}, 2) + O_2(\mathbf{a}, 0)$ $O_2(\mathbf{b}, 1) + O_2(\mathbf{x}, 0) \rightarrow O_2(\mathbf{x}, 1) + O_2(\mathbf{b}, 0)$	1.52×10^{-11}
92	$O_2(b,2) + O_2(X,0) \rightarrow O_2(X,2) + O_2(b,0)$	1.7×10^{-12}
93	$O_2(b,3) + O_2(X,0) \rightarrow O_2(X,2) + O_2(b,0)$	1.5×10^{-13}
94	$H_2O(010) + H_2O \rightarrow H_2O(000) + H_2O$	5.0×10^{-11}
95	$O_2(a,1) + I_2(X) \rightarrow O_2(X) + I_2(A')$	2.0×10^{-12}
96	$O_2(a, 1) + I_2(X) \rightarrow O_2(X) + I_2(X)$ $O_2(a, 2) + I_2(X) \rightarrow O_2(X) + I_2(A)$	3.0×10^{-11}
97	$O_2(a, 2) + I_2(X) \rightarrow O_2(X) + I_2(X)$ $O_2(a, 3) + I_2(X) \rightarrow O_2(X) + 2I$	1.0×10^{-11}
	$O_2(a, 3) + I_2(X) \rightarrow O_2(X) + 2I$ $O_2(a) + I_2(X, 11 \le v \le 24) \rightarrow O_2(X) + I_2(A')$	
	$O_2(a) + I_2(X, \Pi \leqslant v \leqslant 24) \rightarrow O_2(X) + I_2(X)$ $O_2(a, 1) + I_2(X, v \geqslant 15) \rightarrow O_2(X) + 2I$	1.0×10^{-11}
	$O_2(a, 1) + I_2(X, v \ge 13) \rightarrow O_2(X) + 2I$ $O_2(a, 2) + I_2(X, v \ge 8) \rightarrow O_2(X) + 2I$	1.0×10^{-11} 1.0×10^{-11}
	$\mathbf{O}_2(a,2) + \mathbf{I}_2(\mathbf{A},b \geqslant 0) \rightarrow \mathbf{O}_2(\mathbf{A}) + \mathbf{I}_2$	

^{*} Если размерность не приведена, константа скорости измеряется в см 3 /с; ** обычным шрифтом приведены процессы из СКП [11]; *** жирным шрифтом приведены дополняющие СКП процессы [124]; в процессах (76)-(85) и (89)-(93) цифрами в скобках обозначены номера колебательного уровня O_2 .

Константы скоростей процессов заселения и дезактивации электронно-возбужденных состояний $O_2(a)$, $O_2(b)$ и I^* найдены с высокой точностью [56–63]. Анализ скоростей процессов в активной среде ХКИЛ и методов их измерения проведен в работах [11, 46, 54]. К малоизученным относятся процессы с участием колебательно-возбужденного кислорода $O_2(v)$, никак не представленные в СКП [11]. Это в первую очередь обусловлено тем, что регистрация $O_2(v)$ в активной среде КИЛ представляет собой сложную проблему из-за отсутствия у молекулы кислорода дипольного момента.

2.1. Регистрация колебательно-возбужденных молекул O_2

Дезактивация электронной энергии в EV-процессах (1), (5), (9), (33), (44), (45) и (48) в активной среде КИЛ приводит к образованию колебательно-возбужденных молекул О2, Н2О и І2. В реакции пулинга (1) образуется колебательно-возбужденный кислород $O_2(b, v)$ с вероятностями выхода 0.32, 0.04 и 0.64 для v = 0, 1 и 2 соответственно [115]. Как распределяется выделяющаяся энергия между продуктами реакции пулинга (44) – неизвестно. Вероятность образования колебательно-возбужденной молекулы $H_2O(001)$ в реакции (5) равна 0.1 [116]. Расчеты показывают, что большая часть энергии, выделяющейся в реакциях (1), (5), (44), поступает в колебательные степени свободы продуктов [116]. В реакции (48) образуется колебательно-возбужденная молекула Н₂O(002) [117]. В работах [118-120] обнаружено образование колебательно-возбужденного иода $I_2(X, 11 \le v \le 45)$ в реакции (33). Колебательно-возбужденные $I_2(v)$ и $O_2(v)$ играют важную роль в процессах формирования активной среды ХКИЛ, особенно при диссоциации I_2 .

Только в нескольких работах сообщается о регистрации $O_2(v)$ в среде КИЛ. В [121] было зарегистрировано излучение колебательно-возбужденных $O_2(a,v=1)$ и $O_2(b,v=1)$ в реакционной зоне барботажного ГСК. Лиленфельд [55] обнаружил наличие $O_2(X,v)$ на выходе химического ГСК с использованием ЭПР-спектроскопии. Однако в этих работах не удалось определить количественное содержание $O_2(v)$. Относительное содержание $O_2(a,v)$ впервые было определено с использованием экспериментальной методики, основанной на сравнении интенсивностей I_{634} и I_{579} полос люминесценции димоля кислорода с центрами на длинах волн $\lambda=634$ и 579 нм соответственно [122]:

$$\begin{aligned} \mathbf{O}_2(\mathbf{a}, v = 0) + \mathbf{O}_2(\mathbf{a}, v' = 0) \\ &\rightarrow \mathbf{O}_2(\mathbf{X}, v = 0) + \mathbf{O}_2(\mathbf{X}, v' = 0) + hv_{634}, \\ \mathbf{O}_2(\mathbf{a}, v = 1) + \mathbf{O}_2(\mathbf{a}, v' = 0) \\ &\rightarrow \mathbf{O}_2(\mathbf{X}, v = 0) + \mathbf{O}_2(\mathbf{X}, v' = 0) + hv_{579}. \end{aligned}$$

Полоса излучения с $\lambda=579$ нм принадлежит димолю кислорода, образованному из двух молекул синглетного кислорода, одна из которых колебательно возбуждена с v=1. Скорость R испускания фотонов димолем определяется как произведение константы скорости на концентрации молекул кислорода: $R_{579}=K_{579}[{\rm O}_2({\rm a},v=0)]\times [{\rm O}_2({\rm a},v=1)]$ и $R_{634}=K_{634}[{\rm O}_2({\rm a},v=0)][{\rm O}_2({\rm a},v=0)]$. Эти скорости связаны с интенсивностями излучения I_{579} и I_{634} соотношением $R_{579}/R_{634}=I_{579}/I_{634}$ [122]. После подста-

новки в него экспериментально найденного отношения интенсивностей излучения $I_{579}/I_{634}\approx 0.02$ [122] и отношения констант скоростей $K_{579}/K_{634}=0.93$ [123] была найдена относительная колебательная населенность синглетного кислорода на выходе струйно-капельного генератора: $[O_2(a,v=1)]/[O_2(a,v=0)]\simeq 0.02$ [122].

Колебательно-возбужденный кислород в активной среде ХКИЛ был зарегистрирован в проточной камере низкого давления с использованием эмиссионной методики, основанной на анализе спектров люминесценции молекул О2 на электронно-колебательно-вращательных переходах $O_2(b, v = i) \rightarrow O_2(X, v' = i) + hv_i$, где i = 0, 1или 2 [77, 78, 80]. Синглетный кислород генерировался в струйном ГСК. Давление газа $P_{\rm g}$ в реакционной зоне ГСК составляло \sim 35 Тор. Газ с выхода ГСК подавался в измерительную ячейку. В поток кислорода на расстоянии 16 см от выхода ГСК инжектировались пары иода с несущим его газом (N2). Давление газа в измерительной ячейке $P_{\rm c}$ составляло ~ 3 Тор. Точка наблюдения располагалась вдоль по потоку на расстоянии $L=5\ \mathrm{cm}$ от места инжектции иода [80]. На рис.1 представлен спектр излучения $O_2(b)$ в интервале длин волн $\lambda = 757 - 785$ нм для двух значений начальной доли молекулярного иода в потоке $\eta_{\rm I_2} = G_{\rm I_2}/G_{\rm Cl_2}~(G_{\rm I_2},\,G_{\rm Cl_2}$ – расход $\rm I_2,\,Cl_2$ соответственно). Расходы хлора G_{Cl_2} и несущего пары I_2 буферного газа N_2 были одинаковыми: $G_{\text{Cl}_2} = G_{\text{N}_2} = 2.5$ ммоль/с. На рис.1 символами R(bi-Xi) и P(bi-Xi) обозначены контуры вращательных R- и P-ветвей для трех переходов $O_2(b, v = i) \rightarrow O_2(X, v' = i) + hv_i$. Интенсивность I_{bi-Xi} излучения полосы bi - Xi пропорциональна произведению $\sigma_i^3 q_{i,i} N_{bi}$ [115], где N_{bi} – концентрация кислорода $O_2(b, v = i); \ \sigma_i, \ q_{i,i}$ – волновое число и коэффициент Франка – Кондона для перехода bi-Xi соответственно. Для перехода b2 – X2 интенсивность излучения в P-ветви сравнима с шумами регистрирующей аппаратуры. На контур перехода Р(b1-X1) накладывается дополнительная полоса излучения с центром на $\lambda \approx 774$ нм. Полосы излучения переходов в R-ветвях отчетливо видны и не перекрываются другими полосами излучения. Относительные концентрации колебательно-возбужденных молекул на первом $(N_{\rm b1})$ и втором $(N_{\rm b2})$ колебательных уровнях находились из соотношений [80]

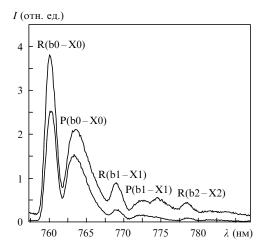


Рис.1. Спектр излучения $O_2(b)$ при $N_2:O_2:H_2O=100:100:4$, $P_g\approx 35$ Top, $P_c=3$ Top, L=5 см, $\eta_{\Delta}=60$ %, относительном содержании воды $\eta_{w}=3$ % в случае $\eta_{1_2}=0.83$ % (верхняя кривая) и $\eta_{I_2}=0.31$ % (нижняя кривая); R(bi-Xi), P(bi-Xi) – контуры R- и P-полос излучения молекулы кислорода $O_2(b,v=i)\to O_2(X,v'=i)+hv$ [80].

$$\eta_{\rm b1} = \frac{N_{\rm b1}}{N_{\rm b0}} = \frac{\sigma_0^3 I_{\rm R(b1-X1)} q_{00}}{\sigma_1^3 I_{\rm R(b0-X0)} q_{11}}, \quad \eta_{\rm b2} = \frac{N_{\rm b2}}{N_{\rm b0}} = \frac{\sigma_0^3 I_{\rm R(b2-X2)} q_{00}}{\sigma_2^3 I_{\rm R(b0-X0)} q_{22}}$$

где $I_{R(b-Xi)}$ — интенсивность излучения в R-ветви для v=i. Доля колебательно-возбужденных молекул $O_2(b)$ для первого и второго колебательных уровней в максимуме составила 22 % и 10 % [80].

Наиболее полный перечень процессов с участием $O_2(v)$ представлен в недавней работе [124]. В ней СКП [11] был дополнен новыми процессами и новыми кинетическими данными, полученными за последние десять лет. Добавленные процессы выделены в табл. 1 жирным шрифтом [124]. Перераспределение колебательных квантов энергии между молекулами кислорода $O_2(a)$, $O_2(b)$ и О₂(X) осуществляется в ходе быстрых ЕЕ-энергообменных процессов (89)-(93). В результате среднее число колебательных квантов, приходящихся на каждую из молекул кислорода $(O_2(X), O_2(a))$ или $O_2(b)$, практически одинаково [78, 80]. Константы скоростей ЕЕ-обмена О₂(b, v = 1, 2 и 3) с молекулами $O_2(X)$ в процессах (91)-(93) измерены в работах [125, 126]. Как видно из табл.1, их значения с ростом и уменьшаются, что авторы работ [125, 126] связывают с увеличением теплового эффекта реакции с ростом v. В [127] измерены константы скоростей EE-обмена $O_2(a, v = 1 \text{ и 2})$ с молекулами $O_2(X)$ (процессы (89) и (90)).

Константы скоростей VV-обмена $K_{v',v''}^{\rm O_2}$ в процессе ${\rm O}_2({\rm X},v')+{\rm O}_2({\rm X},v'')\to {\rm O}_2({\rm X},v'-1)+{\rm O}_2({\rm X},v''+1)$ измерены только для нескольких значений v' и v''. В работе [128] рассчитана константа скорости $K_{1,0}^{\rm O_2}=10^{-13}~{\rm cm}^3/{\rm c}$. Константы $K_{2,0}^{\rm O_2}=2\times 10^{-13}~{\rm cm}^3/{\rm c}$ (процесс (76)) и $K_{3,0}^{\rm O_2}=2.6\times 10^{-13}~{\rm cm}^3/{\rm c}$ (процесс (77)) были измерены в [129]. Остальные значения $K_{v',v''}^{\rm O_2}$ можно рассчитать из соотношения, приведенного в [130]: $K_{v',v''}^{\rm O_2}=10^{-13}(v'+1)v''\times {\rm exp}[-\delta_{\rm VV}|v'+1-v''|][1.5-0.5~{\rm exp}\,(-\delta_{\rm VV}|v'+1-v''|)]~{\rm cm}^3/{\rm c}$, где $\delta_{\rm VV}=0.4(300/T)^{1/2}$.

Отличительной особенностью кинетики активной среды ХКИЛ является низкая скорость VT-релаксации $O_2(v)$ при взаимодействии с молекулами O_2 , N_2 , H_2O в процессах (70)-(73). Убыль энергии из колебательного резервуара кислорода осуществляется преимущественно в ходе VV'-обмена с молекулами H_2O в процессе (85). Данный процесс играет важную роль в колебательной кинетике кислорода. В моделях, описывающих динамику колебательно-возбужденного кислорода в атмосфере, используется константа скорости $K_{85} = 1.7 \times 10^{-12} \text{ см}^3/\text{c}$ [131]. В [132] рекомендовано значение $K_{85} = 5.5 \times 10^{-13} \text{ см}^3/\text{c}$, полученное на основе критического анализа всех измерений константы скорости процесса (85). Колебательно-возбужденные молекулы воды релаксируют в ходе быстрого VT-процесса (94).

К сожалению, мало данных о распределении энергии, выделяющейся в процессах (1), (3), (5), (9), (44) и (45), по продуктам реакций. На основе сравнения расчетных и экспериментальных данных оценено, что около 4.5 колебательных кванта образуется при тушении одной молекулы $O_2(a)$ в активной среде ХКИЛ [133, 134]. В [135] рекомендуется использовать следующие значения вероятностей колебательного возбуждения продуктов реакций $\gamma_{i,j}$ (вероятность возбуждения i-го колебательного уровня молекулы O_2 в j-м процессе из табл.1): $\gamma_{1,1}=0$, $\gamma_{2,1}=1$, $\gamma_{3,3}=1$, $\gamma_{1,5}=0$, $\gamma_{2,5}=0$, $\gamma_{3,5}=1$, $\gamma_{1,9}=0$, $\gamma_{2,9}=0$, $\gamma_{3,9}=1$, $\gamma_{1,44}=0$, $\gamma_{2,44}=1$, $\gamma_{1,45}=0$, $\gamma_{2,45}=0$, $\gamma_{3,45}=1$. Значения $\gamma_{i,j}$ были выбраны таким образом, чтобы об-

щее число колебательных квантов, зарождающихся при тушении одной молекулы $O_2(a)$, не превышало 4.5.

Эксперименты и расчеты показывают [77 – 80, 122, 133 – 137], что среднее число колебательных квантов, приходящихся на одну молекулу O_2 , может достигать $\eta_v = \sum_n n\eta_n \approx 0.3-0.4 \ (\eta_n = [O_2(v=n)]/[O_2] -$ доля колебательно-возбужденных молекул O_2 на n-м колебательном уровне, $n=1,2,3\ldots$). В связи с этим молекулы $O_2(a,v=1)$ и $O_2(a,v=2)$ наряду с $O_2(a,v=0)$ будут участвовать в инвертировании лазерного перехода в процессах

$$\begin{split} &O_2(a, \upsilon = 0) + I \leftrightarrow O_2(X, \upsilon = 0) + I^* + 279 \text{ cm}^{-1}, \\ &O_2(a, \upsilon = 1) + I \leftrightarrow O_2(X, \upsilon = 1) + I^* + 207 \text{ cm}^{-1}, \\ &O_2(a, \upsilon = 2) + I \leftrightarrow O_2(X, \upsilon = 2) + I^* + 131 \text{ cm}^{-1}. \end{split}$$

Тепловой эффект реакций, а следовательно, и константы равновесия указанных процессов, с ростом v уменьшаются. При этом пороговое долевое содержание $\eta_{\Delta}^{\text{th}}$ с ростом доли колебательно-возбужденных молекул O_2 увеличивается [134]. Так, например, при T=300~K пороговое значение $O_2(a)$ для $\eta_v=0.4$ будет составлять ~ 18 %, тогда как для $\eta_v=0$ оно составляет 15%. Коэффициент усиления среды с ростом η_v уменьшается незначительно [134].

2.2. Образование и релаксация $I_2(v)$

Колебательно-возбужденный иод $I_2(X, v)$, образующийся в реакции (33), может играть важную роль в процессе диссоциации молекулярного иода. В нескольких работах [118-120] были зарегистрированы высокие относительные концентрации $I_2(X, v)$ в кислородно-иодной среде. В работе [119] экспериментально показано, что в реакции (33) образуются колебательно-возбужденные молекулы иода $I_2(X, 25 < v < 43)$. Возбужденные атомы иода генерировались фотолизом смесей I₂-Ar на длине волны 475 нм или смесей CF₃I-I₂-Ar на длине волны 266 нм. Молекулы $I_2(X, v)$ регистрировались с помощью метода лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ) на переходе $I_2(B \to X)$. В работах [118, 120] молекулы $I_2(X, v)$ были обнаружены в смеси $I_2 - O_2(a) - O_2$ также с использованием метода ЛИФ. В этих экспериментах $O_2(a)$ нарабатывался в разрядном ГСК, на выходе из которого в кислородный поток инжектировались пары I_2 . В столкновениях с молекулами $O_2(a)$ иод диссоциировал на атомы; возбужденный атомарный иод образовывался в ходе ЕЕ-передачи энергии в процессе (40). В [118] удалось зарегистрировать $I_2(X, v)$ с колебательными квантовыми числами в диапазоне $33 \le v \le 44$. Авторы [120] экспериментально нашли распределение абсолютных концентраций молекул иода по колебательным уровням в диапазоне $5 \le v \le 45$ (рис.2).

Для описания динамики колебательного возбуждения в молекулярном иоде необходимо знать вероятности образования в реакции (33) молекул $I_2(X)$ на v-м колебательном уровне γ_v . В [138] приведено распределение γ_v по колебательным уровням ($24 \le v \le 47$) в относительных единицах, полученное на основе анализа результатов измерений относительных населенностей $I_2(X,v)$. Положение вершины в этом распределении γ_v приходится на уровень с v=40. Из сравнения расчетных концентраций [$I_2(X,v)$] с экспериментальными данными работы [120] найдено, что в ходе реакции (33) суммарная вероятность $\Gamma_{25 \le v \le 46} = \sum_{v=25}^{46} \gamma_v$ образования молекул $I_2(X,v) > 24$) равна ~ 0.1 , а суммарная вероятность прямого возбуж-

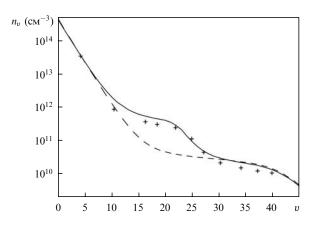


Рис.2. Населенности молекул $I_2(X,v)$ на расстоянии 3 см от места инжекции иода в поток кислорода для условий экспериментов работы [120]: начальный состав смеси $O_2(X)$: $O_2(a)$: $I_2=0.92$: 0.08: 0.0475 Тор, начальная скорость потока $10.8\,$ м/с, начальная температура газовой смеси $300\,$ К. Сплошная кривая — результаты расчетов при $\Gamma_{v>23}=0.1\,$ и $\Gamma_{15\leqslant v\leqslant 23}=0.9\,$ штриховая — при $\Gamma_{v>23}=0.1\,$ и $\Gamma_{15\leqslant v\leqslant 23}=0.9\,$ крестики — экспериментальные данные, взятые из работы [120].

дения молекул иода на колебательные уровни с 15 по 24 составляет около 0.9 [139]. На рис.2 приведены расчетные значения населенностей молекул $I_2(X, v)$ при $\Gamma_{v>23}=0.1$, $\Gamma_{15\leqslant v\leqslant 23}=\sum_{15}^{23}\gamma_v=0.9$ и экспериментально измеренные концентрации [$I_2(X,v)$]. Видно, что результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными. При этом, если положить в расчетах $\Gamma_{15\leqslant v\leqslant 23}=0$, расчетные значения концентраций молекул $I_2(X,15\leqslant v\leqslant 23)$ (штриховая кривая на рис.2) окажутся на порядок меньше экспериментально измеренных при 10< v< 30.

Анализ измеренных значений [$I_2(X, v)$] показал, что распределение γ_v по колебательным уровням имеет два максимума: при v=40 [138] и при v=20-22 [139]. Необычное двухвершинное распределение γ_v можно объяснить двумя различными механизмами протекания реакции (33):

$$\begin{split} &I_2(X) + I^* \to I_2(X, \upsilon > 24) + I, \\ &I_2(X) + I^* \to I_3 \to I_2(X, 10 < \upsilon \leqslant 24) + I. \end{split}$$

В первой реакции (33) в ходе EV-передачи энергии образуются молекулы $I_2(X, v > 24)$ с распределением по колебательным уровням, приведенным на рис.7 из работы [138]. Вторая реакция (33) протекает с образованием промежуточного комплекса I_3 [64]. Полученное двухвершинное распределение γ_v позволяет предположить, что коэффициенты ветвления для первой и второй реакций (33) равны примерно 0.1 и 0.9 соответственно.

Скорости релаксации молекул $I_2(X, v)$ изучались в работах [138, 140]. Константы скоростей вращательно-колебательной релаксации $I_2(X, v, J)$ на компонентах He, Ar, N_2 , O_2 , Cl_2 , I_2 и H_2O приведены в [138] для следующих комбинаций колебательных (v) и вращательных (J) уровней: v=23, J=57; v=38, J=49 и v=42, J=17. На первом этапе импульсным излучением перестраиваемого лазера на красителе, накачиваемого лазером на неодимовом стекле, возбуждались вращательно-колебательно-электронные состояния $I_2(B, v', J')$. Импульс второй аналогичной лазерной системы стимулировал переход $I_2(B, v', J') \rightarrow I_2(X, v, J)$, заселяя тем самым выбранные для исследования вращательно-колебательные уровни основного электронного состояния. Относительные населен-

ности состояний $I_2(X, v, J)$ измерялись с помощью пробного лазерного импульса, который возбуждал $X \to D$ переход. Для этого использовалось излучение третьего перестраиваемого лазера на красителе с удвоенной частотой. Для получения относительных населенностей $I_2(X, v, J)$ детектировалась лазерно-индуцированная флуоресценция $I_2(D \to X)$ вблизи 321 нм. Экспериментально были определены константы скоростей релаксации $I_2(X, v, J)$ для v = 23, J = 57; v = 38, J = 49 и v = 42, J = 17(см. табл.1 в [138]). Численный анализ спектра ЛИФ позволил также определить константы скоростей VT-релаксации иода $K_{v,v-1}^{\mathrm{M}}$ для v=23 и 38 и $\mathrm{M}=\mathrm{He},\mathrm{Ar},\mathrm{N}_2,\mathrm{O}_2,\mathrm{Cl}_2,$ I_2 и H_2 О. Значения $K_{v,v-1}^{\rm M}$ для v=23 и 38 оказались близкими. Поскольку измерения были проведены только для двух значений и и точность измерений была невысокой, зависимость константы скорости VT-релаксации от номера колебательного уровня найдена не была. Авторы [138] предположили, что в соотношении $K_{v,v-1}^{\rm M} =$ $v^n K_{1,0}^{M}$ значение n лежит в диапазоне 0-1. В работе [138] рассчитаны значения $K_{v,v-1}^{\rm M}$ для n=0 и 1; данные для n = 1 приведены в табл. 1 (процессы (35) – (39)).

2.3. Кинетика электронно-возбужденных молекул $I_2(A^{\,\prime},\,A,\,B)$

Интенсивное желто-зеленое свечение наблюдается при добавлении I_2 в поток синглетного кислорода. Оно вызвано радиационным переходом $I_2(B) \to I_2(X)$. Механизм возбуждения $I_2(B)$ в активной среде КИЛ до конца не ясен. В работе [26], где впервые наблюдали это явление, было сделано предположение, что $I_2(B)$ образуется в рекомбинационном процессе (63). Дервент и Траш [27, 28] показали, что данный рекомбинационный процесс не может объяснить ряд особенностей наблюдаемого излучения. Они привели доводы в пользу другого механизма образования $I_2(B)$ — в последовательности процессов (24) и (26).

В недавней работе [136] получены зависимости относительных концентраций [І2(В)] вдоль координаты по потоку в проточной камере для смеси $O_2(a) - I_2 - N_2$ (или СО2) из измерения интенсивности излучения на переходе $I_2(B) \to I_2(X)$. Интенсивности излучения в максимумах падают обратно пропорционально давлению N_2 (рис.3,a) и CO_2 (рис.3,6). Это обусловлено индуцированной столкновениями диссоциацией $I_2(B)$ в процессе (27). Согласно механизму, предложенному Дервентом и Трашем, интенсивность излучения на переходе $I_2(B \to X)$ должна быть обратно пропорциональна квадрату парциального давления углекислого газа, т. к. СО2 является эффективным тушителем как $O_2(b)$, так и $I_2(B)$. Наблюдаемая интенсивность практически обратно пропорциональна давлению СО₂. Этот факт позволил сделать вывод, что роль $O_2(b)$ в процессе формирования $I_2(B)$ несущественна и что механизм Дервента и Траша несостоятелен [136].

Отметим некоторые особенности в распределениях интенсивности излучения молекулярного иода на рис.3. Подъем на начальном участке объясняется увеличением скорости образования $I_2(B)$ в процессах с участием возбужденного атомарного иода. В момент достижения максимума свечения на переходе $I_2(B \to X)$ успевают продиссоциировать приблизительно 50% молекул I_2 [70]. Спад интенсивности свечения обусловлен убылью I_2 в результате диссоциации.

Ожидалось, что люминесценция $I_2(B)$ должна исчезать после завершения диссоционного процесса. В реаль-

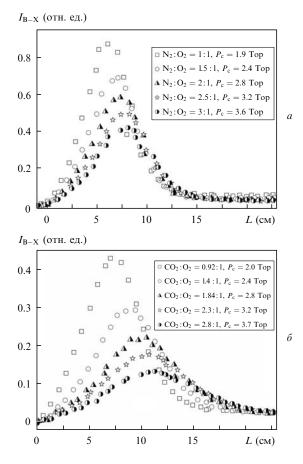


Рис.3. Распределения интенсивностей излучения молекулярного иода на переходе $I_2(B-X)$ вдоль координаты по потоку L при $\eta_{\Delta}=60$ %, $\eta_{\rm w}=3$ % и $\eta_{I_2}=0.28$ % для кислородно-иодной смеси, разбавленной азотом (a) и углекислым газом (δ) [136].

ности же в последиссоционной зоне наблюдается плато в интенсивности излучения на переходе $I_2(B) \to I_2(X)$ [136], как это видно из рис. 3. Данное явление наблюдалось также в [28, 70, 118]. Авторы [28] предположили, что стационарная концентрация I_2 поддерживается в смеси за счет рекомбинации атомарного иода на стенках камеры. Чтобы проверить данное предположение, в [136] в поток газа за зоной диссоциации вставлялись тонкие пластины из различных материалов с целью увеличения скорости рекомбинации атомов иода на стенках и соответственно стационарной концентрации [I_2]. Интенсивность излучения на переходе $I_2(B \to X)$ была практически одинаковой в присутствии и в отсутствие пластин. Это свидетельствует о том, что вклад гетерогенной рекомбинации в образование $I_2(B)$ незначителен.

Анализируя спектры излучения кислородно-иодной среды, можно сделать некоторые выводы относительно механизма формирования $I_2(B)$ и его роли в процессе диссоциации I_2 . На рис.4 показан типичный спектр излучения кислородно-иодной среды в видимой области в зоне диссоциации иода. Спектр испускания в интервале длин волн $500 \leqslant \lambda \leqslant 730$ нм с максимумом на $\lambda \approx 570$ нм принадлежит молекулярному иоду, излучающему свет на переходе $I_2(B) \to I_2(X)$. Спектр ихлучения за зоной диссоциации в интервале $500 \leqslant \lambda \leqslant 730$ нм идентичен спектру на рис.4, но его интенсивность более чем на порядок слабее [136]. В длинноволновой части спектра на рис.4 ($\lambda \approx 750-800$ нм) видны полосы излучения кислорода на переходах $O_2(b,v') \to O_2(X,v'')$. Молекулы в электрон-

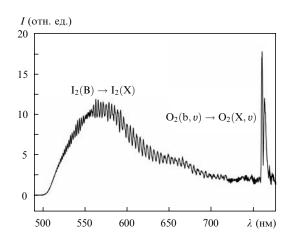


Рис.4. Распределение по длинам волн интенсивности излучения кислородно-иодной среды в зоне диссоциации I_2 при $P_g\approx 35$ Top, $P_c=2.3$ Top, $\eta_{I_2}=0.5$ %, $\eta_{\Delta}=60$ %, $\eta_{w}=3$ %, L=4 см и N_2 : $O_2=1:1$ [136].

но-возбужденном состоянии $I_2(B)$ могут образовываться при рекомбинации атомов I^* и I в процессе (63) или при ЕЕ-передаче энергии иоду $I_2(A,A')$ от синглетного кислорода (26). Доминирующим каналом тушения $I_2(B)$ при давлениях газа, превышающих 1 Тор, является индуцированная столкновениями диссоциация (27). Убыль $I_2(B)$ в процессе спонтанной диссоциации (30) и в процессе спонтанного излучения (31) в условиях активной среды КИЛ незначительна.

Концентрация $I_2(B)$ в кислородно-иодной среде оценена в [136] путем сравнения интенсивностей излучения на переходах $I_2(B-X)$ и $O_2(b-X)$. Отношения I_{B-X}/I_{b-X} интегральных интенсивностей излучения на переходах $I_2(B-X)$ и $O_2(b-X)$ равны ~ 21.8 в зоне диссоциации и ~ 2.3 за зоной. С другой стороны, отношение интенсивностей излучения на переходах $I_2(B-X)$ и $O_2(b-X)$ связано с концентрациями $[I_2(B)]$ и $[O_2(b)]$ соотношением

$$\frac{I_{\mathrm{B-X}}}{I_{\mathrm{b-X}}} = \frac{[\mathrm{I_2(B)}]\Gamma_{\mathrm{B}}}{[(\mathrm{O_2(b)}]\Gamma_{\mathrm{b}}},$$

где $\Gamma_{\rm B}=6\times 10^5~{\rm c}^{-1}$ и $\Gamma_{\rm b}=0.08~{\rm c}^{-1}$ – скорости уменьшения [I₂(B)] и [O₂(b)] в результате спонтанного излучения. Для экспериментальных условий, соответствующих рис.4, примерная концентрация молекул O₂(b) составляет 10^{14} см⁻³ [135]. Отсюда оцененная концентрация [I₂(B)] в зоне диссоциации составляет $3.5\times 10^8~{\rm cm}^{-3}$. Это значение должно быть на три порядка больше, чтобы обеспечить наблюдаемые в эксперименте [135] скорости диссоциации иода только за счет реакции (27). Таким образом, роль I₂(B) в процессе диссоциации незначительна [136]. Наиболее вероятно, что в диссоциацию иода вовлечено несвязанное состояние $I_2(^1\Pi_{1u})$, образующееся в процессе $I_2(A,A')+O_2(a)\to I_2(^1\Pi_{1u})+O_2(X)$. Кроме того, молекула $I_2(A,A')$ диссоциирует при «тепловых» соударениях в реакциях (29.2) и (29.4) [141].

Если предположить, что $I_2(B)$ образуется в результате рекомбинации (63), то оцененное отношение интенсивностей I_{B-X}/I_{b-X} равно ~ 3.5 [136]. Таким образом, скорость рекомбинационного процесса не обеспечивает требуемых скоростей образования $I_2(B)$ в зоне диссоциации, но может обеспечить их за этой зоной [136].

Недавно в [136] предложен механизм образования $I_2(B)$ с вовлечением электронно-возбужденных состояний

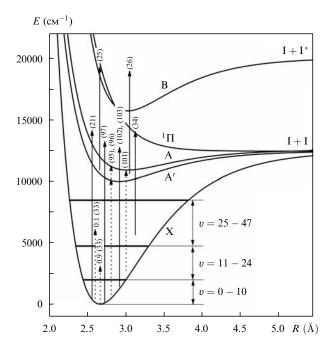


Рис. 5. Кривые потенциальной энергии молекулы I_2 . Пунктирными и сплошными стрелками показаны каналы возбуждения состояний, лежащих ниже и выше предела диссоциации I_2 соответственно. Над стрелками указаны номера процессов из табл. 1.

 $I_2(A',A)$, которые заселяются при столкновениях $I_2(X)$ с молекулами $O_2(a,v=1,2)$ (процессы (95) и (96)) или $I_2(X,11\leqslant v\leqslant 24)$ и $O_2(a)$ (процесс (101)). Механизм образования состояний A' и A молекулы I_2 (стрелки (95), (96) и (101)), канал образования колебательно-возбужденного $I_2(X)$ на колебательных уровнях в диапазоне $11\leqslant v\leqslant 24$ (стрелка 0.9(33)), а также процесс накачки $I_2(B)$ из состояний A', A (стрелка (26)) иллюстрирует рис.5.

Спектр излучения на переходе $I_2(B) \rightarrow I_2(X)$ (рис.4) имеет одинаковую структуру как в зоне, так и за зоной диссоциации. Это означает, что механизмы образования $I_2(B)$ в обеих зонах сходны. В зоне диссоциации механизм образования $I_2(B)$ включает в себя процессы (95), (96), (101) и (26) с участием промежуточного состояния $I_2(A, A')$. В последиссоционной зоне механизм образования $I_2(B)$ тот же. В ходе гомогенной рекомбинации (62) поддерживается незначительная стационарная концентрация молекул $I_2(X)$. Этим объясняется плато в зависимости интенсивности излучения иода от координаты по потоку в последиссоционной зоне (см. рис. 3).

Кинетика дезактивации $I_2(A')$ при столкновениях с CO_2 , Ar, O_2 , H_2O и I_2 исследовалась в работах [135, 141, 142]. Возбуждение А'-состояния осуществлялось по следующей схеме. На первом этапе излучением эксимерного лазера ($\lambda = 193$ нм, длительность импульса 10 нс) инициировался переход $I_2(X) \to I_2(D)$. Далее при столкновениях $I_2(D)$ с аргоном образовывались молекулы $I_2(D')$, которые переходили в А'-состояние в результате спонтанного радиационного перехода $I_2(D') o I_2(A') + hv$ [141]. Зондирующий импульс перестраиваемого лазера на красителе возбуждал переход $D \leftarrow A'$. Чтобы получить лазерные импульсы с длиной волны вблизи 285 нм, частота излучения лазера на красителе удваивалась. Время задержки между лазерными импульсами регулировалось генератором задержек. ЛИФ-сигнал на переходе $I_2(D') \to I_2(A')$ вблизи $\lambda = 340$ нм выделялся монохроматором и детектировался фотоумножителем. Измеренные константы скоростей тушения $I_2(A')$ представлены в табл.1 (процессы (28)-(29.4)). Интересно отметить, что константа скорости тушения $I_2(A')$ гомоядерной молекулой кислорода $(6.3 \times 10^{-12} \text{ см}^3/\text{c})$ больше констант скоростей тушения молекулами CO_2 и H_2O . На основании этого факта в [135] утверждается, что высокая скорость тушения $I_2(A')$ молекулами O_2 обусловлена EE-передачей энергии в процессе $I_2(A') + O_2(X) \rightarrow I_2(X) + O_2(a)$, в результате которого могут образовываться также колебательно-возбужденные продукты. Этот процесс, имеющий большое значение для понимания механизма диссоциации I_2 в активной среде КИЛ, наблюдался и в экспериментах, проводимых с использованием матриц аргона с добавками I_2 и O_2 (при криогенной температуре) [143].

2.4. Каналы диссоциации І2 в активной среде КИЛ

Механизм диссоциации I_2 в КИЛ до сих пор не выяснен. Энергия возбуждения $O_2(a)$ (7882 см $^{-1}$) недостаточна для диссоциации молекулы I_2 (12441 см $^{-1}$) за одно столкновение. Надежно установлено, что процесс диссоциации имеет инициирующую и цепную стадии и что в этом процессе задействовано промежуточное возбужденное состояние I_2 . Однако не выявлено, какое возбужденное состояние I_2 является промежуточным, и не определен механизм накачки этого состояния. Было предложено несколько механизмов диссоциации I_2 в лазерной среде КИЛ.

Дервент и Траш [27, 28] выдвинули предположение, что I_2 диссоциирует при столкновении с $O_2(b)$ (13121 cm^{-1}) в процессе (21). Данный процесс с газокинетической константой скорости хорошо объясняет динамику диссоциации в экспериментах с проточной камерой [70]. Прямыми измерениями в [74] показано, что константа K_{21} намного меньше газокинетической, и поэтому скорость процесса (21) не может обеспечить наблюдаемых темпов диссоциации I₂. В недавней работе [75], где предпринята еще одна попытка измерения константы K_{21} , было найдено, что ее значение превышает ранее измеренное $(3.5 \times 10^{-11} \text{ против } 4 \times 10^{-12} \text{ см}^3/\text{с} [74])$. Однако любое из этих значений K_{21} много меньше, чем того требует модель диссоциации, предложенная Дервентом и Трашем [27, 28]. Скорость процесса (21) много меньше наблюдаемых скоростей диссоциации иода не только на цепной, но и на инициирующей стадии [135, 144].

В СКП [11] заложен механизм, предложенный в работе [70], в котором на инициирующей стадии диссоциация проходит через последовательность процессов (32) и (34). В этой модели промежуточным состоянием служит молекула иода $I_2(X, v)$ в основном электронном состоянии $I_2(X)$ с колебательными квантовыми числами выше v = 23. За инициирующей следует цепная стадия, описываемая последовательностью реакций (40), (33) и (34). Недавно полученные экспериментальные данные ставят под сомнение этот механизм диссоциации. Значения констант скоростей реакций, дезактивирующих промежуточное состояние, в СКП [11] больше подходят для тушения электронно-возбужденного состояния [55, 68], а не $I_2(X, v)$. К тому же прямо измеренное значение константы скорости тушения $O_2(a)$ молекулами $I_2(X)$ (процесс (32)) по меньшей мере на порядок меньше [69], чем принято в СКП [11]. Недавно в [139] показано, что суммарная вероятность $\Gamma_{v>23}$ образования молекул $I_2(X, v>23)$ при тушении I^* молекулами $I_2(X)$ составляет ~ 0.1 . Стандартная модель диссоциации с этим значением вероятности не обеспечивает наблюдаемые скорости распада I_2 . К тому же, если верна эта модель, количество молекул синглетного кислорода, необходимое для диссоциации одной молекулы I_2 , должно превышать 20, что противоречит экспериментальным данным.

Арнольд и др. [26] предположили, что электронновозбужденный иод $I_2(A',A)$ может быть вовлечен в процесс диссоциации в последовательности реакций

$$O_2(a) + I_2(X) \rightarrow O_2(X) + I_2(A', A),$$

$$O_2(a) + I_2(A',A) \rightarrow O_2(X) + 2I.$$

Нижними электронно-возбужденными состояниями иода являются $A'^{\bar{3}}\Pi_{2u}$ и $A^{\bar{3}}\Pi_{1u}$ с энергиями возбуждения 10047 и 10847 см $^{-1}$ соответственно. Разность энергий состояний $O_2(a)$ и $I_2(A',A)$ много больше энергии тепловых соударений. Поэтому ЕЕ-передача энергии от О₂(а) не может обеспечить необходимых темпов заселения $I_2(A', A)$. Однако следует отметить, что электронновозбужденные молекулы І₂(А', А) обнаружены в смеси $O_2(a) - I_2$ [70, 143, 145, 146]. Дэвид [145] наблюдал свечение на переходе $I_2(A \to X)$ при добавлении в поток молекул О₂(а) паров молекулярного иода. Хайднеру с соавторами [70] также удалось зарегистрировать люминесценцию на переходе $I_2(A \to X)$ в газовой смеси $O_2(a) - I_2$. Нижнее электронно-возбужденное состояние І₂(А') является метастабильным и не может быть обнаружено с помощью эмиссионной спектроскопии. В работе [146] наблюдали $I_2(A')$ в смеси $O_2(a) - I_2$ с использованием ЛИФ с возбуждением перехода D' - A'.

Механизм возбуждения А'- и А-состояний I₂ в смеси $O_2(a) - I_2$ не установлен. Можно предположить, что различие в энергиях возбуждения $I_2(A', A)$ и $O_2(a)$ компенсируется энергией колебательного возбуждения синглетного кислорода. В пользу этого предположения свидетельствуют работы [77-80, 122, 133-136], в которых сообщается об обнаружении высоких неравновесных концентраций $O_2(X, v)$, $O_2(a, v)$ и $O_2(b, v)$ в активной среде КИЛ. Колебательно-возбужденный О2 может участвовать в диссоциации I_2 в энергообменных процессах (95), (96). Тепловой эффект процессов (95) и (96) (623 и 23 см⁻¹ соответственно) может быть компенсирован кинетической энергией сталкивающихся частиц. В этом случае скорости данных реакций способны обеспечить темпы диссоциации I_2 . Энергия, запасенная в $O_2(a, v = 3)$, достаточна, чтобы привести к диссоциации І2 за одно столкновение [76].

Модель диссоциации, в которой промежуточными состояниями служат нижние электронно-возбужденные состояния A' и A молекулы I_2 , накачиваемые в ходе энергообменных процессов (95) и (96), получила название модели ЛАХ (Лиленфельд – Азязов – Хэвен) [144]. Эта модель хорошо объясняет темпы диссоциации иода в экспериментах с проточной камерой [135], где начальная концентрация I_2 в иодном потоке была всего в два раза выше, чем в полностью перемешанном потоке. В реальных смесительных устройствах локальная концентрация паров I_2 в струях, инжектируемых в кислородный поток, намного больше, чем в полностью перемешанном потоке. В этих экспериментальных условиях [144] скорости диссоциации намного выше, чем следует из модели ЛАХ. Розенвакс с сотрудниками [144] дополнили модель ЛАХ процессами из модели Хайднера [70]:

$$\begin{split} & I_2(X) + I^* \to I_2(X, \upsilon > 23) + I, \\ & I_2(X, \upsilon \geqslant 23) + O_2(a) \to I + I + O_2(X), \\ & I_2(X, \upsilon \geqslant 23) + M \to I_2(X) + M. \end{split}$$

Скомбинированная таким образом модель получила название ХЛАХ [144]. При этом скорость диссоциации иода на инициирующей стадии обеспечивалась процессами, входящими в модель ЛАХ, а на цепной стадии – процессами из модели Хайднера. Трехмерные расчеты течения реагирующей газовой смеси с использованием уравнений Навье – Стокса и модели ХЛАХ хорошо воспроизводили темпы диссоциации иода в сверхзвуковом ХКИЛ [144]. В этих расчетах было сделано допущение, что суммарная вероятность образования $I_2(X, v > 23)$ в процессе (33) равна единице. Однако недавно было показано [139], что данное значение на порядок меньше. Таким образом, модель ХЛАХ также не может обеспечить наблюдаемых в эксперименте скоростей диссоциации иода.

Модель ЛАХ получила развитие в работе [124], где развита модель, согласно которой промежуточные состояния І₂(А', А) возбуждаются, в дополнение к процессам (95) и (96), при столкновениях колебательно-возбужденных молекул $I_2(X, 11 \le v \le 24)$ с $O_2(a)$ (процесс (101)). Молекулы $I_2(X, 11 \le v \le 24)$ образуются в процессе (33) с квантовым выходом 0.9 [139]. В развитую модель был также включен процесс прямой диссоциации иода в столкновениях с $O_2(b)$ с константой скорости $K_{21} = 3.5 \times 10^{-11}$ см³/с [75]. Кроме того, необходимо отметить, что суммарная энергия сталкивающихся частиц в процессах (97), (102) и (103) превышает энергию диссоциации І2. Вклад этих каналов в диссоциацию тем больше, чем выше доля колебательно-возбужденных молекул O_2 и I_2 в смеси. Наиболее вероятно, что процесс диссоциации иода в присутствии О2(а) протекает одновременно по нескольким каналам, как это следует из рис.5. Пунктирными стрелками показаны каналы возбуждения промежуточных состояний, а сплошными - каналы, по которым происходит диссоциация иода.

Многопараметрическое экспериментальное исследование кинетики диссоциации иода в синглетном кислороде проведено в [135] с использованием эмиссионной методики в проточной камере низкого давления. В данной работе измерены профили концентраций возбужденных состояний вдоль координаты по потоку в широком диапазоне изменений состава смеси. Для примера на рис.6 представлены распределения концентраций возбужденных атомов иода І* вдоль координаты по потоку L при разбавлении кислорода азотом в соотношении $O_2: N_2 = 1:1$, относительном содержании паров воды в кислороде $\eta_{\rm w} = [{\rm H_2O}]/[{\rm O_2}] \approx 3 \,\%$ и относительной доле ${
m O}_2({
m a})~\eta_{\Delta} = 60~\% \pm 10~\%$ для нескольких значений относительных начальных концентраций I_2 из диапазона $\eta_{I_2} =$ 0.18 % – 1.44 %. На этом же рисунке приведены расчетные распределения концентраций I* (сплошные кривые), полученные с использованием развитой многоканальной модели диссоциации [124] при тех же условиях, что и в эксперименте. Расчетные данные оказались весьма чувствительными к значениям K_{101} и η_{Δ} . Удовлетворительное согласие между расчетными и экспериментальными данными было достигнуто при $K_{101} = 10^{-12} \text{ cm}^3/\text{c}$ и $\eta_{\Lambda} =$ 60%.

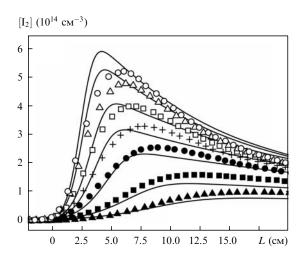


Рис.6. Зависимости концентрации I* от координаты по потоку L при $\eta_{\rm w}=3$ %, $\eta_{\Lambda}=60$ % \pm 10 %, N_2 : $O_2=1$: 1 для следующих условий: $\eta_{\rm I_2}=1.44$ %, $P_{\rm c}=2.2$ Тор (\odot) ; $\eta_{\rm I_2}=1.23$ %, $P_{\rm c}=2.2$ Тор (\triangle) ; $\eta_{\rm I_2}=0.94$ %, $P_{\rm c}=2.1$ Тор (\Box) ; $\eta_{\rm I_2}=0.7$ %, $P_{\rm c}=2.1$ Тор (+); $\eta_{\rm I_2}=0.52$ %, $P_{\rm c}=2.0$ Тор (\bullet) ; $\eta_{\rm I_2}=0.29$ %, $P_{\rm c}=1.9$ Тор (\blacksquare) ; $\eta_{\rm I_2}=0.18$ %, $P_{\rm c}=1.8$ Тор (\triangle) . Кривые – результаты расчетов при $\eta_{\Delta}=60$ % и $K_{\rm 101}=10^{-12}$ см³ $(c_{\rm I}135)$

В реальных лазерных системах локальная концентрация I_2 в струях, инжектируемых в кислородный поток, много выше концентрации иода в полностью перемешанном потоке. Розенвакс с сотрудниками обнаружили [147], что развитая многоканальная модель диссоциации с константой скорости $K_{101}=10^{-12}~{
m cm}^3/{
m c}$ предсказывает в шесть раз меньшую скорость диссоциации, чем наблюдалась в их эксперименте [144]. Они сделали заключение, что константа скорости процесса (101) должна быть на порядок выше. Однако модель с $K_{101}=10^{-11}~{
m cm}^3/{
m c}$ предсказывает существенно завышенные скорости диссоциации для условий экспериментов с проточной камерой [135]. Это различие в значениях K_{101} можно объяснить погрешностью измерений η_{Δ} , которая составляла ± 10 %. Многоканальная модель диссоциации [124] также обеспечивает удовлетворительное согласие расчетных данных с экспериментальными при $\eta_{\Delta} = 50 \,\%$ и $K_{101} \approx 10^{-11}$ cm^3/c . Наиболее вероятно, что K_{101} лежит в диапазоне $10^{-12} - 10^{-11} \text{ cm}^3/\text{c}.$

Анализ результатов расчетов показал, что большая часть молекул иода в ходе диссоциации проходит через А'- и А-состояния, которые возбуждаются в процессах (95) и (96) с участием колебательно-возбужденного кислорода и в процессе (101) с участием колебательно-возбужденного иода $I_2(X, 11 \le v \le 24)$ [124]. Процессы (95), (96) и (25) обеспечивают диссоциацию на инициирующей стадии. Вклад этой последовательности процессов в диссоциацию на цепной стадии является определяющим при относительных начальных локальных концентрациях иода $\eta_{\rm I_2} < 1$ %, а вклад процесса (101) существен только на цепной стадии и только при $\eta_{\rm I_2} \geqslant 1 \%$. Таким образом, диссоциация I₂ – пример процесса, в который активно вовлечены как колебательно-, так и электронно-возбужденные состояния. Канал диссоциации, предложенный Хайднером [70], дает малый вклад при суммарной вероятности образования $I_2(X, v \ge 25)$ в процессе (33) $\Gamma_{v \geqslant 25} = 0.1$. Вклад процессов прямой диссоциации иода (21), (97), (102) и (103) также незначителен.

3. Кинетика образования и гибели $O_2(a)$ и I^* в активных средах ЭКИЛ и ФКИЛ

Процессы образования и гибели $O_2(a)$ в плазме электрического разряда активно исследовались в работах [21, 22, 31–41, 148–151]. Выход возбужденных молекул кислорода $O_2(a)$ из разрядной зоны определяется в основном возбуждением и дезактивацией кислорода при столкновениях с электронами плазмы. Полная кинетическая схема процессов в среде электроразрядного ГСК приведена в работах [22, 32, 150]. Анализ плазмохимических процессов в смесях, содержащих кислород, показал, что оптимальное значение η_{Δ} реализуется при $E/N \approx 10$ Тд [21, 22, 31, 32, 150] (E — напряженность электрического поля, N — концентрация частиц в газе).

С целью использования в КИЛ исследовалось множество типов разрядов: разряд постоянного тока [149], радиочастотный [32-34, 36-38, 41, 148] и микроволновый [35] разряды, несамостоятельные разряды, инициируемые электронным пучком [31] и импульсной предыонизацией [40, 151]. В несамостоятельном разряде можно реализовать режимы с низкими значениями приведенного поля ($E/N \le 10$ Тд) при давлениях кислорода несколько десятков торр [31, 40]. Несамостоятельный разряд, поддерживаемый внешним электронным пучком, остается стабильным при энерговкладах 150 кДж/моль для смеси O_2 – Ar – CO с общим давлением 30 Top [31]. В работе [31] теоретически показано, что в данном типе разряда предельная доля η_{Λ} может достигать 25 %. Недавно в [40] исследованы характеристики несамостоятельного разряда в смеси O_2 : He = 1:10, инициируемого импульсной предыонизацией при общем давлении 120 Тор. Однако выход η_{Λ} был невысок – всего 6 %. Относительно большое значение $\eta_{\Delta}~(\sim 30~\%)$ было получено в [151] при использовании внешней предыонизации и общем давлении газовой смеси 60-100 Тор.

Доля синглетного кислорода на выходе электроразрядных ГСК в лучшем случае равна или чуть выше пороговой доли $\eta_{\Delta}^{\,\mathrm{th}}$ при комнатной температуре. Пороговое значение О2(а) падает с уменьшением температуры газа. Положительный коэффициент усиления можно получить даже при $\eta_{\Delta} \approx 15\,\% - 20\,\%$, используя охлаждение газа при адиабатическом расширении в сверхзвуковом сопле. Относительно низкое давление кислорода на выходе электроразрядного ГСК (несколько торр) не позволило получить большой коэффициент усиления [33, 35]. Для повышения эффективности работы ЭКИЛ необходимо поднимать давление кислорода на выходе генератора до нескольких десятков торр. Однако рост давления О2 сопровождается падением коэффициента усиления, что обусловлено присутствием на выходе электроразрядного ГСК атомов кислорода $O(^{3}P)$.

Атомарный кислород играет в ЭКИЛ двоякую роль. Он ускоряет диссоциацию молекулярного иода, но также дезактивирует как $O_2(a)$, так и I^* . Как показано в [22, 32], с увеличением давления кислорода выход $O_2(a)$ падает. Авторы этих работ выдвинули предположение, что увеличение скорости дезактивации $O_2(a)$ с ростом давления O_2 обусловлено протеканием трехчастичного процесса (2.38). (Рассматриваемые в разд.3 процессы представлены в табл.2.) Чтобы обеспечить скорость уменьшения $[O_2(a)]$ в этих экспериментах, константа скорости процесса (2.38) $K_{2.38}$ должна находиться в пределах $(1-3) \times 10^{-32}$ см⁶/с.

Табл.2. Дополнительные процессы, характерные для ЭКИЛ и ФКИЛ, и их константы скорости.

	л, и их константы скорости.		
Номе реак-	р Реакция	Константа	Лите-
ции		скорости *	ратура
2.1	$O_3 + hv \rightarrow O(^1D) + O_2(a)$	0.9**	[155]
	$O_3 + hv \rightarrow O(^3P) + O_2(X)$	0.1 **	[155]
2.2	$CF_3I + hv \rightarrow CF_3 + I^*$	0.89 **	[156]
	$CF_3I + hv \rightarrow CF_3 + I$	0.11 **	[156]
2.3	$N_2O + hv \rightarrow O(^1D) + N_2$	0.995**	[157]
2.4	$O(^1D) + N_2O \rightarrow NO + NO$	7.2×10^{-11}	[157]
2.5	$O(^1D) + N_2O \rightarrow N_2 + O_2(a)$	4.4×10^{-11}	[157]
2.6	$O(^1D) + N_2O \rightarrow O(^3P) + N_2O$	1.0×10^{-12}	[157]
2.7	$O_2(a) + I \rightarrow O_2(X) + I^*$	7.8×10^{-11}	[11]
2.8	$O_2(X) + I^* \rightarrow O_2(a) + I$	2.7×10^{-11}	[11]
2.9	$I^* + O_2(a) \rightarrow I + O_2(b)$	1.1×10^{-13}	[11]
2.10	$I^* + O_2(a) \rightarrow I + O_2(a)$	1.1×10^{-13}	[11]
2.11	$I^* + I_2(X) \to I + I_2(X)$	3.8×10^{-11}	[11]
2.12	$I^* + O(^3P) \rightarrow I + O(^3P)$	1.2×10^{-11}	[158]
2.13	$I^* + NO_2 \rightarrow I + NO_2$	2.9×10^{-15}	[159]
2.14	$I^* + N_2O_4 o $ продукты	3.5×10^{-13}	[159]
2.15	$I^* + N_2O \rightarrow I + N_2O$	1.4×10^{-15}	[159]
2.16	$I^* + IO \rightarrow I + IO$?	
2.17	$I^* + O_3 o $ продукты	1.8×10^{-12}	[158]
2.18	$I + O_3 \rightarrow IO + O_2 \\$	1.2×10^{-12}	[157]
2.19	$I_2(X) + O(^3P) \rightarrow IO + I$	1.4×10^{-10}	[160]
2.20	$IO + O(^3P) \rightarrow O_2(X) + I$	1.5×10^{-10}	[160]
2.21	$IO + IO \rightarrow I + IO_2$	3.2×10^{-11}	[157]
2.22	$IO + IO \rightarrow 2I + O_2$	8.0×10^{-12}	[157]
2.23	$IO + NO \rightarrow I + NO_2$	1.82×10^{-11}	[157]
2.24	$O(^1D) + N_2 \rightarrow O(^3P) + N_2$	2.6×10^{-11}	[157]
2.25	$O(^1D) + CO_2 \rightarrow O(^3P) + CO_2$	1.3×10^{-10}	[161]
2.26	$O(^1D) + Ar \rightarrow O(^3P) + Ar$	5.0×10^{-13}	[161]
2.27	$O(^{1}D) + O_{2} \rightarrow O(^{3}P) + O_{2}(X, a, b)$	4.0×10^{-11}	[157]
2.28	$O(^3P) + NO_2 \rightarrow O_2(X,a) + NO$	1.0×10^{-11}	[157]
2.29	$O_2(a) + IO \rightarrow O_2(X) + IO$?	
2.30	$\mathrm{O}_2(a) + \mathrm{O}_3 \to \mathrm{O}_2(X) + \mathrm{O}_3$	3.8×10^{-15}	[150]
2.31	$O_2(a) + O(^1D) \to O_2(X) + O(^3P)$	1.0×10^{-11}	[150]
2.32	$O_2(a) + O(^3P) \to O_2(X) + O(^3P)$	7.0×10^{-16}	[22]
2.33	$O_2(a) + CF_3O \rightarrow O_2(X) + CF_3O$	4.5×10^{-11}	[162]
2.34	$O_2(b) + O_3 o $ продукты	1.9×10^{-11}	[163]
2.35	$O_2(b) + O(^3P) \rightarrow O_2(X,a) + O(^3P)$	8.0×10^{-15}	[150]
2.36	$O(^3P) + O_2 + Ar \rightarrow O_3 + Ar$	$4.0 \times 10^{-34} \text{ cm}^6/\text{c}$	[164]
2.37	$O(^3P) + O_2 + O_2 \rightarrow O_3 + O_2$	$6.0 \times 10^{-34} \text{ cm}^6/\text{c}$	[157]
2.38	$O(^{3}P) + O_{2}(a) + O_{2} \rightarrow O(^{3}P) + 2O_{2}$	$1.1 \times 10^{-31} \text{ cm}^6/\text{c}$	[163]
2.39	$O(^3P) + NO + M \rightarrow NO_2^* + M$	$1.0 \times 10^{-31} \text{ cm}^6/\text{c}$	[157]

^{*} Если размерность не приведена, константа скорости измеряется в см³/с; ** квантовый выход каналов процессов при УФ фотолизе.

Тушение I* атомами O (3 P) в послеразрядной зоне изучалось в [33, 35]. В этих работах регистрировались распределения концентраций I* и коэффициента усиления среды вдоль по потоку. Было обнаружено, что при добавлении в поток молекул NO₂ темп релаксации электронной энергии резко снижался. Молекула NO₂ реагирует с атомарным кислородом в процессе (2.28) и связывает его. Было сделано предположение, что электронная энергия расходуется в процессе (2.12). Авторы работ [33, 35] на основе моделирования кинетики процессов в послеразрядной зоне получили оценочное значение константы скорости процесса (2.12) $K_{2.12}$, лежащее в пределах

 $(0.4-1.0) \times 10^{-11} \, \mathrm{cm^3/c}$. Положительные коэффициенты усиления были получены при добавлении в поток газа, выходящего из электроразрядного ГСК, паров молекулярного иода как в сверхзвуковом [33], так и в дозвуковом [35] режимах течения. В этих работах использовались радиочастотный [33] и микроволновой [35] разряды. Первая генерация была получена с электроразрядным ГСК, в котором использовался радиочастотный разряд [34]. Выходная мощность ЭКИЛ составила 220 мВт. В дальнейшем мощность излучения была увеличена до 12.3 Вт [152].

Возможность использования УФ фотолиза О3 для получения О₂(а) в КИЛ была рассмотрена в работах [153, 154]. Квантовый выход $O_2(a)$ при УФ фотолизе O_3 в процессе (2.1) близок к 90 % [155], что определяет перспективность данного способа возбуждения лазерного перехода $I^* \to I$. Генерация КИЛ при импульсном фотолизе озона излучением лазера на неодимовом стекле (четвертая гармоника, $\lambda = 264$ нм) была впервые получена в работе [154]. Для смеси $CF_3I:O_3:SF_6:He:N_2O=0.055:$ 0.45:11:21:6 Тор получен энергосъем 0.8 мДж/см^3 при эффективности преобразования энергии О2(а) в лазерное излучение около 41 %. Особенностью фотолизного ГСК является высокая концентрация продуктов фотолиза $O(^{1}D)$ и $O(^{3}P)$ и не разложившегося O_{3} . Атомы $O(^{1}D)$ эффективно тушат как O₂(a), так и I* [154]. Для удаления $O(^{1}D)$ из смеси использовались $N_{2}O$, CO_{2} и N_{2} (процессы (2.4) – (2.6), (2.24) и (2.25)). Молекула N₂O реагирует с $O(^{1}D)$ в химических реакциях (2.4)—(2.6), удаляя атомарный кислород из смеси. Энергия лазерного импульса при использовании смесей с N₂O была существенно выше, чем при использовании СО2 и N2. Было сделано предположение [154], что атомарный кислород эффективно тушит I^* (процесс (2.12)) и что в процессе (2.5) образуется $O_2(a)$, хотя прямые доказательства этих предположений отсутствовали. Кроме того, непродиссоциировавший озон также тушит I^* в процессе (2.17).

Хотя фотолизный ГСК обеспечивает высокий квантовый выход $O_2(a)$, он не получил широкого распространения по двум основным причинам: нестабильность исходного реагента (озон) и низкая (около 25 %) эффективность преобразования световой энергии в энергию возбуждения кислорода, что обусловлено большим различием между энергией $\mathbf{V}\Phi$ фотона и энергией возбуждения $O_2(a)$.

3.1. Тушение $O_2(a)$ в смеси $O(^3P) - O_2(X) - O_2(a)$

Прямое измерение скорости дезактивации синглетного кислорода в смесях, содержащих атомы и молекулы кислорода, было проведено в работе [163] с использованием импульсного лазерного фотолиза (ИЛФ) смеси $O_3-O_2-Ar-CO_2$ на длине волны 248 нм. Атомы кислорода и молекулы синглетного кислорода нарабатывались фотолизом озона в процессе (2.1). Скорость дезактивации O_2 (а) определялась из временных профилей интенсивностей излучения на переходе O_2 (а – X). На рис.7 показана типичная временная зависимость интенсивности излучения O_2 (а) вблизи $\lambda=1268$ нм после ИЛФ смеси O_2-O_3-Ar при давлении кислорода $P_{O_2}=680$ Тор, парциальном давлении аргона $P_{Ar}=90$ Тор, начальном давлении озона $P_{O_3}=2.4$ Тор, T=300 К и удельной энергии лазерного импульса $E_{las}=80$ мДж/см².

Временные профили концентрации атомарного кислорода находились по хемилюминесцентной реакции $O + NO + M \rightarrow NO_2^* + M + hv$. Для этого в смесь O_2-

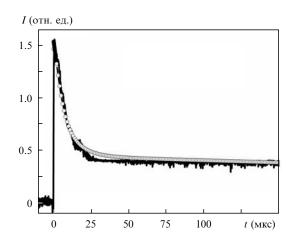


Рис.7. Типичная временная зависимость интенсивности излучения молекул $O_2(a)$ после лазерного фотолиза смеси O_2-O_3-A г при $P_{O_2}=680$ Тор, $P_{\rm Ar}=90$ Тор, $P_{O_3}=2.4$ Тор, $E_{\rm las}=80$ мДж/см² и T=300 К (сплошная кривая). Точки – результаты расчетов при условиях эксперимента и $K_{2.38}=1.1\times 10^{-31}$ см 6 /с [163].

 O_3 —Aг добавлялось незначительное количество закиси азота N_2O . Молекулы NO нарабатывались в ходе быстрой химической реакции (2.4). На рис.8 показана зависимость интенсивности излучения хемилюминесцентной реакции вблизи $\lambda=600$ нм от времени после ИЛФ смеси O_2 — O_3 —Ar— N_2O на длине волны 248 нм при $P_{O_2}=654$ Тор, $P_{\rm Ar}=108$ Тор, $P_{O_3}=2.5$ Тор, $P_{\rm N_2O}=2.8$ Тор, $E_{\rm las}=80$ мДж/см² и T=300 К. Из расчетов следует, что концентрация молекул NO была практически постоянной за все время наблюдения, поэтому временную зависимость интенсивности излучения можно соотнести с зависимостью относительной концентрации атомов $O(^3P)$ от времени.

На профиле интенсивности излучения кислорода на переходе $O_2(a) \rightarrow O_2(X)$, изображенном на рис.7, можно выделить два участка. На начальном участке кривой, на временном интервале до 20 мкс, интенсивность излучения резко падает приблизительно в четыре раза. При t > 20 мкс профиль интенсивности более пологий, что хорошо объясняется релаксацией $O_2(a)$ на озоне в процессе (2.30). Быстрая релаксация $O_2(a)$ на временном масштабе не более 20 мкс необычна, поскольку молекула синглет-

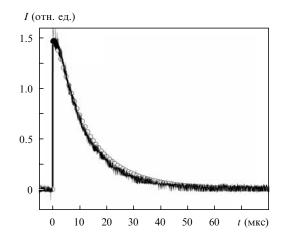


Рис.8. Временной профиль интенсивности излучения вблизи $\hat{\lambda}=600$ нм хемилюминесцентной реакции после ИЛФ смеси $O_2-O_3-Ar-N_2O$ на длине волны 248 нм при $P_{O_2}=654$ Тор, $P_{Ar}=108$ Тор, $P_{O_3}=2.5$ Тор, $P_{N_2O}=2.8$ Тор, $E_{las}=80$ мДж/см² и T=300 К. Точки – расчетные значения произведения [O][NO] [163].

ного кислорода чрезвычайно слабо дезактивируется при столкновениях.

Из рис.8 видно, что в процессе (2.37) атомы $O(^{3}P)$ рекомбинируют за временной промежуток, примерно равный времени спада концентрации О2(а) на начальном участке кривой рис.7. Быстрое тушение $O_2(a)$ имеет место только в присутствии атомов $O(^3P)$. Это подтверждает выдвинутое в работах [22, 32] предположение о том, что быстрое тушение $O_2(a)$ в присутствии атомов кислорода обусловлено трехчастичным процессом (2.38). Экспериментальные данные по дезактивации О2(а) обрабатывались с учетом этого предположения. Скорость спада $[O_2(a)]$ на начальном участке кривой хорошо воспроизводилась расчетами при константе скорости процесса (2.38) $K_{2.38}=1.1 \times 10^{-31} \, \, \mathrm{cm}^6/\mathrm{c}$ [163]. Данное значение существенно выше значений $K_{2.38} = (1-3) \times 10^{-32}$ см⁶/с, полученных в работах [22, 32] на основе моделирования кинетических процессов в послеразрядной зоне.

Временные профили интенсивностей излучения $O_2(a)$ на длине волны 1268 нм были получены для различных составов смеси $O_2-O_3-Ar-CO_2$. Скорость дезактивации $O_2(a)$ оставалась неизменной при варьировании парциального давления Ar. Это противоречит данным, полученным в работах [22, 32]. Авторы этих работ обнаружили, что скорость релаксации $O_2(a)$ в послеразрядной зоне увеличивается с ростом содержания Ar в исходной смеси. Этот факт они объяснили тушением $O_2(a)$ в процессе $O(^3P) + O_2(a) + Ar \rightarrow O(^3P) + O_2 + Ar$ с константой скорости $0.63K_{2,38}$.

Колебательно-возбужденный озон $O_3(v=1)$ дезактивирует $O_2(a)$ в реакции $O_3(v=1)+O_2(a)\to 2O_2+O$ в 38 раз быстрее, чем невозбужденный (v=0) [165]. В процессах (2.36) и (2.37) образуются около пяти колебательных квантов на различных модах O_3 . Можно предположить, что колебательно-возбужденный озон с v>1 может более эффективно тушить $O_2(a)$. Этот механизм необходимо иметь в виду при интерпретации быстрой релаксации $O_2(a)$ в присутствии атомарного и молекулярного кислорода [166].

Концентрация атомарного кислорода на выходе из электроразрядного ГСК соизмерима с концентрацией $O_2(a)$. Удаление $O(^3P)$ из смеси должно приводить к росту производительности ГСК благодаря исключению канала потерь (2.38). Недавно авторам работы [38] удалось увеличить содержание $O_2(a)$ на выходе радиочастотного разряда (81 МГц) с 10% - 12% до 16% за счет покрытия стенок разрядной камеры окисью ртути (для удаления избытка кислородных атомов). При этом давление кислорода удалось увеличить в пять раз по сравнению с давлением, достигнутым в ранних работах [22, 32].

3.2. Квантовый выход $O_2(a)$ в реакциях $O(^1D)$ с N_2O и $O(^3P, ^1D)$ с NO_2

УФ фотолиз N_2O широко используется как источник электронно-возбужденных атомов $O(^1D)$ (процесс (2.3)). Реакция фотофрагмента $O(^1D)$ с N_2O протекает по трем каналам: (2.4), (2.5) и (2.6). Эти реакции интенсивно изучались, т. к. один из продуктов (молекула NO) участвует в процессах разрушения озонового слоя [167]. Закон сохранения спина и ab initio расчеты [168] предсказывают образование синглетного кислорода $O_2(a)$ в реакции (2.5).

Для инициирования фотохимических реакций, в частности реакции (2.5), в работе [169] использовался ИЛФ. Квантовый выход атомов $O(^1D)$ при фотолизе N_2O на

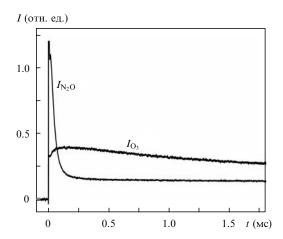


Рис.9. Временные зависимости интенсивности излучения O_2 (а) вблизи 1268 нм при фотолизе смеси O_3-N_2 (I_{O_3}) с $P_{N_2}=773.7$ Тор, $P_{O_3}=1.3$ Тор и смеси N_2O-Ar (I_{N_2O}) с $P_{N_2O}=207$ Тор и $P_{Ar}=407$ Тор [169].

длине волны 193 нм составляет 0.995 [157]. Излучение кислорода на переходе а-Х выделялось интерференционным фильтром ($\lambda \approx 1268$ нм) и регистрировалось германиевым фотодетектором (ADC 403HS, время отклика ~ 1 мкс), охлаждаемым жидким азотом. После воздействия лазерного импульса в течение длительного времени наблюдалось излучение с максимумом спектра вблизи 1268 нм, что подтверждает образование О₂(а). Кривая $I_{\rm N_2O}$ на рис. 9 – это временная зависимость интенсивности излучения вблизи $\lambda = 1268$ нм при фотолизе смеси N_2O- Ar ($P_{\text{N}_2\text{O}} = 207$ Top, $P_{\text{Ar}} = 407$ Top). Быстрый спад интенсивности (0-0.2 мc) на начальном участке кривой определяется излучением электронно-возбужденных молекул NO₂*, формирующихся в процессе (2.39). Молекулы NO образуются в реакции (2.4), а атомы $O(^{3}P)$ – в реакции (2.6). Заметим, что излучение молекул NO_2^* при экстремально низких концентрациях может быть сравнимо по интенсивности с излучением О2(а) благодаря огромному различию радиационных времен жизни NO_2^* и $O_2(a)$ (10^8 раз). Интенсивность $I_{\rm N,O}$ практически постоянна при t > 0.3 мс, и это ее значение использовалось при определении концентрации молекул О₂(а), нарабатываемых в процессе (2.5).

Калибровка детектирующей аппаратуры для измерения концентраций О₂(а) осуществлялась с использованием ИЛ Φ смеси $O_3 - N_2$ на длине волны 248 нм. Квантовый выход синглетного кислорода в процессе (2.1) $\eta_{\Delta,2,1} =$ $[O_2(a)]/[O_2]$ близок к 0.9 [155]. Зависимость I_{O_3} на рис.9 является типичной временной зависимостью интенсивности излучения О₂(а) после ИЛФ озона. Сигнал непосредственно после фотолиза (t = 0) пропорционален концентрации молекул $O_2(a)$, произведенных в течение времени воздействия фотолизного импульса. Небольшой рост сигнала на начальном участке кривой (0.0-0.2 мс) обусловлен дополнительной наработкой О2(а) при трехчастичной рекомбинации кислородных атомов [72]. Спад интенсивности определяется, в основном, тушением О₂(а) молекулами О₃. Число молекул О₂(а), образованных при фотолизе О₃, определяется следующим выражением:

$$N_{\Delta}^{\mathrm{O}_{3}} = \frac{\Delta E_{248} \lambda_{248}}{hc} \, \eta_{\Delta, 2.1}, \label{eq:N_Delta}$$

где ΔE — доля энергии лазерного импульса, поглощенная в фотолизном объеме.

Число молекул $O_2(a)$, произведенных в процессе (2.5), определяется из выражения

$$N_{\Delta}^{\rm N_2O} = \frac{\Delta E_{193} \lambda_{193}}{hc} \, \gamma_{2.5} \eta_{\Delta,2.5},$$

где $\gamma_{2.5}=K_{2.5}/(K_{2.4}+K_{2.5}+K_{2.6}),$ а $\eta_{\Delta,2.5}$ – квантовый выход $O_2(a)$ в реакции (2.5). Используя тот факт, что интенсивность излучения на длине волны 1268 нм прямо пропорциональна концентрации $O_2(a)$, из соотношения $N_{\Delta}^{O_3}/N_{\Delta}^{N_2O}=I_{O_3}/I_{N_2O}$ можно легко найти искомую величину $\eta_{\Delta,2.5}$:

$$\eta_{\Delta,2.5} = \frac{I_{\rm N_2O}}{I_{\rm O_3}} \frac{\Delta E_{248} \lambda_{248}}{\Delta E_{193} \lambda_{193}} \frac{\eta_{\Delta2.5}}{\gamma_{2.5}} = 3.08 \; \frac{I_{\rm N_2O}}{I_{\rm O_3}} \frac{\Delta E_{248}}{\Delta E_{193}}.$$

В табл.3 представлены данные для определения квантового выхода $O_2(a)$ в процессе (2.5). Обработка данных показала, что квантовый выход близок к единице: $\eta_{\Delta,2.5}=1.00\pm0.12$.

Табл.3. Данные для определения $\eta_{\Delta,2.5}$ квантового выхода $O_2(a)$ в процессе (2.5) [169].

$I_{\text{N}_2\text{O}}$ (MB)	<i>I</i> _{O₃} (мВ)	ΔE_{193} (мДж)	ΔE_{248} (мДж)	$\eta_{\Delta,2.5}$
0.15	0.35	14.4	11.2	1.03
0.15	0.35	15.8	11.2	0.94
0.14	0.33	14.2	11.2	1.03
0.14	0.51	16	18.4	0.97
0.11	0.33	11	11.2	1.05
0.1	0.3	9.2	8.4	0.94
0.14	0.38	12.6	12.6	1.13
0.17	0.54	16.8	16.8	0.97
0.072	0.3	6.4	8.4	0.97
0.14	0.56	12.6	15.6	0.95

На основе моделирования кинетики реакций в послеразрядной зоне авторы работы [84] сделали вывод, что увеличение концентрации I* при добавлении NO₂ не может быть объяснено только удалением из смеси избытка атомов О. Чтобы достичь согласия с наблюдаемыми в эксперименте концентрациями І*, необходимо было вводить в модель дополнительный источник $O_2(a)$. Авторы предположили, что О₂(а) нарабатывается в процессе $O(^{3}P) + NO_{2} \rightarrow O_{2}(a) + NO$. В работе [169] был использован ИЛФ смеси Ar-NO₂ на длине волны 193 нм для определения квантового выхода О₂(а) в реакции (2.28). При фотолизе NO₂ на длине волны 193 нм образуются атомы $O(^3P)$ и $O(^1D)$ с квантовыми выходами 0.45 и 0.55соответственно [170]. Знание этих величин дало возможность определить выход $O_2(a)$ как в реакции (2.28), так и в реакции $O(^{1}D)$ с NO_{2} . При нахождении выхода $O_{2}(a)$ в процессе (2.28) в газовую смесь добавлялся азот, чтобы конвертировать $O(^{1}D)$ в основное состояние $O(^{3}P)$. Эксперименты, проведенные в широком диапазоне изменений параметров, не привели к обнаружению люминесценции $O_2(a)$ вблизи $\lambda=1268$ нм. Чувствительность аппаратуры была достаточной для того, чтобы зарегистрировать это излучение при квантовом выходе $O_2(a)$ в процессе (2.28), превышающем 10 %.

3.3. Тушение I^* атомами $O(^3P)$ и молекулами O_3 , NO_2 , N_2O_4 и N_2O

Поскольку процесс (2.12) является одним из самых быстрых дезактивирующих процессов в ЭКИЛ и ФКИЛ,

очень важно установить значение $K_{2.12}$ с хорошей точностью. В связи с этим целесообразно использование нескольких методик и подходов для ее измерения. В [169] представлены результаты исследований кинетики реакции I^* с $O(^3P)$ при использовании ИЛФ смеси N_2O-I_2- СО2- N2. Создание необходимой концентрации атомов кислорода с помощью фотолиза N2O является важным моментом в экспериментах по определению скорости тушения атомов I* атомарным кислородом. Экспериментальные условия в [169] выбирались таким образом, чтобы скорость тушения I^* атомами $O(^3P)$ доминировала над скоростями тушения такими компонентами, как І2, N₂O, IO и т. д. Молекулярный иод является сильным тушителем I^* (3.8 × 10^{-11} см 3 /с [11]). О скорости тушения I* радикалом IO информации нет. Концентрация атомов О, генерируемых фотолизом N2O, должна быть намного выше начальной концентрации I_2 . В этом случае молекулы I₂ и IO практически полностью прореагируют с кислородом в процессах (2.19) и (2.20). При этом должен оставаться избыток кислородных атомов, тушаших I*, что влечет за собой использование низких начальных концентраций I₂, высоких давлений N₂O и больших энергий лазерных импульсов.

Для детектирования временных зависимостей концентраций I_2 и IO использовался метод ЛИФ [169].

Временные зависимости концентраций I₂ и IO регистрировалась для того, чтобы найти режимы, в которых обеспечивалось быстрое истощение этих компонентов. Более того, временные профили концентраций I₂ использовались для определения концентраций атомов О. На рис. 10 показаны типичные временные профили концентраций I₂. Эксперименты были выполнены со следующими парциальными давлениями газов: $P_{N,O} = 16.7, P_{CO} = 16.7$ 16.7 и $P_{\rm I_2} = 0.0038$ Тор. С учетом того, что константа скорости процесса (2.19) известна с хорошей точностью [160], временные зависимости концентраций I_2 использовались для определения концентраций атомов $O(^3P)$. Так, начальная концентрация атомов $O(^{3}P)$ находилась из условия совпадения расчетных концентраций I₂ (сплошные кривые) с экспериментальными данными (точки).

Эксперименты были проведены при большом превышении $[O(^3P)]$ концентрации молекулярного иода. Моле-

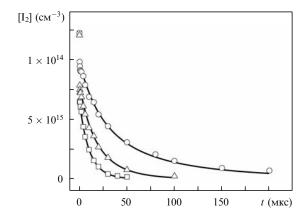


Рис.10. Временные профили концентраций I_2 после ИЛФ смеси $N_2O-I_2-CO_2-Ar$ на длине волны 193 нм при $P_{\text{tot}}=50$ Тор, $P_{\text{CO}_2}=16.7$ Тор, $P_{N_2O}=16.7$ Тор, $P_{I_3}=3.8$ мТор и плотностях энергии импульсов 31.5 (\square), 18 (\triangle) и 10 мДж/см 2 (\bigcirc). Сплошные кривые – результаты расчетов концентраций I_2 для условий экспериментов [169].

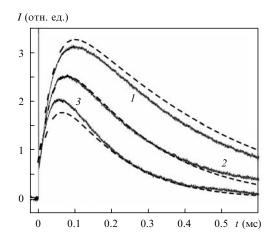


Рис.11. Зависимости интенсивности излучения I^* от времени после ИЛФ смеси $N_2O-I_2-CO_2-A$ г на длине волны 193 нм при $P_{\rm tot}=50$ Тор, $P_{\rm N_2O}=16.7$ Тор, $P_{\rm I_2}=4.1$ мТор, $E_{\rm las}=31.5$ мДж/см² и $P_{\rm CO_2}=8.3$ (I), 16.7 (2) и 33.3 Тор (3); штриховые кривые – результаты расчетов относительных концентраций I^* при $K_{2.12}=1.2\times 10^{11}$ см³/с [169].

кулы І2 и ІО полностью расходовались в химических реакциях за $t \le 100$ мкс. На рис.11 показаны типичные временные профили интенсивностей излучения на переходе $I^* \to I$. Такой вид зависимостей типичен для случаев, когда излучающая частица нарабатывается во вторичных процессах. Рост интенсивностей излучения на начальных участках кривых обусловлен наработкой атомов иода в ходе химических реакций (2.19), (2.20) с их последующим возбуждением в процессе энергообмена (2.7). Спад интенсивностей излучения І* на рис.11 обусловлен дезактивацией возбужденных атомов в процессе (2.12). Численное моделирование фотохимических процессов использовалось для анализа временных профилей концентраций I*. Наилучшее согласие расчетных и экспериментальных результатов было достигнуто при $K_{2,12}$ = $1.2 \times 10^{-11} \text{ cm}^3/\text{c} [169].$

Атомы кислорода участвуют также в образовании озона в процессах (2.36) и (2.37). Озон реагирует как с I^* , так и с I в процессах (2.17) и (2.18). Одним из продуктов этих реакций является короткоживущий радикал IO. В процессе IO + IO нарабатываются молекулы IO_2 и I_2O_2 [171], что нежелательно, т. к. при этом атомы иода выводятся из системы, а продукты реакции IO, IO_2 и I_2O_2 могут тушить I^* и O_2 (а).

Реакция атомарного иода с озоном является одним из каналов потерь O_3 в атмосфере [167]. Константа скорости процесса (2.18) была измерена несколькими методами. В [157] проведен критический анализ этих измерений и рекомендована константы скорости этого процесса, равная $1.2 \times 10^{-12}~{\rm cm}^3/{\rm c}$.

Авторы работы [172] измерили константу скорости процесса (2.17), используя ламповый фотолиз смеси CF_3I-O_3 для наработки возбужденных атомов иода I^* . Измеренная константа скорости тушения I^* озоном составила 1.1×10^{-11} см 3 /с. Широкополосный ламповый фотолиз вызывал фотодиссоциацию не только CF_3I , но и значительного количества O_3 . При фотолизе озона образуются как атомы $O(^3P)$, так и молекулы O_2 , которые являются эффективными тушителями I^* (процессы (2.8) и (2.12)). Продукты фотолиза озона ускоряли темп тушения I^* , что привело в конечном итоге к завышению константы скорости процесса (2.17).

2 Квантовая электроника, т.39, № 11

Константа скорости тушения I^* молекулами O_3 была измерена также в [158] двумя различными методами. В первом из них использовался ИЛФ смеси I_2 – O_3 на λ = 485 нм. Во втором методе [158] для изучения кинетики дезактивации I^* атомами $O(^3P)$ и молекулами O_3 использовался ИЛФ смеси I_2 – O_3 – N_2 излучением на λ = 248 или 266 нм. Фотолиз I_2 излучением на λ = 485 нм (сечение поглощения иодом на этой длине волны равно 1.52×10^{-18} см² [157]) использовался как источник атомов I^* :

$$I_2(X) + hv(485 \text{ HM}) \rightarrow I_2(B) \rightarrow I^* + I,$$

$$I_2(X) + hv(485 \text{ HM}) \rightarrow I_2(^1\Pi_{10}) \rightarrow I + I.$$

Относительный выход возбужденных атомов I^* в данном процессе $\phi = [I^*]/([I^*] + [I])$ лежит в пределах 0.23-0.3 [64, 173]. Сечение поглощения озона на $\lambda = 485$ нм относительно мало: 7×10^{-22} см² [157], поэтому доля фотолизированного O_3 была несущественной.

Временные зависимости интенсивностей излучения атомарного иода на переходе $I^* \to I$ использовались для определения скорости тушения I^* молекулами O_3 . Полученная таким образом константа скорости процесса (2.17) $K_{2.17}$ составила 2.6×10^{-12} см 3 /с [158]. Доля остаточного O_2 в потоке озона не контролировалась, поэтому найденное значение, скорее всего, дает верхнюю границу константы $K_{2.17}$.

Излучение на $\lambda = 248$ и 266 нм слабо поглощается молекулярным иодом. Основными продуктами фотолиза озона на этих длинах волн являются $O(^1D)$ и $O_2(a)$. Электронно-возбужденный атомарный иод нарабатывался в последовательности реакций (2.24), (2.19), (2.20) и (2.7). При этом зависимости интенсивностей люминесценции I* от времени были подобны представленным на рис. 11. Спад интенсивностей излучения обусловлен процессами дезактивации I^* при столкновениях с $O(^3P)$, O_3 и I_2 . Временные зависимости интенсивностей излучения I^* были получены в широком диапазоне изменений составов среды и энергий лазерного фотолизирующего импульса. Константы скоростей процессов (2.12) и (2.17) находились на основе численного анализа временных зависимостей люминесценции І* [158]. Значения констант скоростей процессов, используемых в расчетах, приведены в табл. 2. Наилучшее согласие результатов расчетов и экспериментов было достигнуто при $K_{2.12} = 1.2 \times 10^{-11}$ см 3 /с и $K_{2.17} = 1.8 \times 10^{-12}$ см 3 /с. Значение константы $K_{2.17}$, найденное этим методом, следует считать более точным, нежели измеренное с использованием первого метода, поскольку результаты расчетов были нечувствительны к начальному относительному содержанию кислорода в смеси $I_2-O_3-N_2$ вплоть до $[O_2]/[O_3]\leqslant 10\%$. Различие в константах скоростей $K_{2.17}$, найденных двумя разными методами [158] $(2.6 \times 10^{-12} \text{ против } 1.8 \times 10^{-12} \text{ см}^3/\text{c})$, показывает, что содержание остаточного кислорода в приготовленном для экспериментов озоне составляет $\sim 3 \%$. Найденная в [158] константа скорости тушения I* атомами $O(^{3}P)$ находится в превосходном согласии с ее значением, измеренным в экспериментах по УФ фотолизу смеси $N_2O - I_2 - CO_2 - N_2$ [169].

Добавление NO_2 в смесь на выходе электроразрядного ГСК позволяет снизить темп релаксации запасенной энергии [33]. Оптимальное содержание добавляемого NO_2 должно зависеть от скорости тушения I^* в процессах (2.13) и (2.14). Димер N_2O_4 всегда сопровождает

 NO_2 . В работе [174] впервые была предпринята попытка измерения константы скорости реакции (2.13). Возбужденный атомарный иод нарабатывался с помощью ИЛФ смеси $CF_3I-NO_2-N_2O_4$ на длине волны 248 нм. Оцененная в этой работе константа скорости реакции (2.13) составила 8.5×10^{-14} см 3 /с при комнатной температуре без учета влияния димера N_2O_4 и некоторых вторичных фотохимических процессов.

В [159] представлены результаты измерений констант скоростей процессов (2.13)—(2.15) при температурах газа в интервале 293—380 К. Измерения констант скоростей данных процессов при повышенных температурах были выполнены по нескольким причинам. Во-первых, температура газа в послеразрядной зоне относительно высока (более 400 К), в связи с чем важно выявить температурные зависимости констант скоростей процессов. Во-вторых, содержание димера в смеси сильно уменьшается с увеличением температуры, и чтобы исключить влияние N₂O₄ на измерение константы скорости процесса (2.13), эксперименты выполнялись при температурах выше комнатной.

Для измерений констант скоростей процессов тушения I* окислами азота использовался ИЛФ смеси CF₃I – $NO_2-N_2O_4$ (или N_2O) на длине волны 248 нм [159]; I^* нарабатывался фотолизом СF₃I в процессе (2.2). Отношение квантовых выходов каналов фотодиссоциации CF₃I составляло 0.89: 0.11 [156]. Исследование процесса тушения I* молекулами NO₂ было осложнено влиянием вторичных реакций. Одним из продуктов фотолиза NO₂ является атомарный кислород, который быстро конвертируется в молекулярный в процессе (2.28). Вклад молекулярного кислорода в скорость тушения І* был того же порядка, что и вклад исследуемой молекулы. Чтобы исключить влияние O_2 на скорость дезактивации I^* , измерения проводились при разных удельных энергиях фотолизирующего лазерного импульса $(3.5-12.6 \text{ мДж/см}^2)$ при фиксированном давлении NO2. Затем значения скоростей тушения R экстраполировались линейной функцией к значению E=0. Скорость тушения $R_{E=0}$ равна сумме скоростей тушения молекулами $NO_2\left(R_{NO_2}\right)$ и молекулами примеси $I_2(R_{I_2})$. Скорость тушения R_{NO_2} находилась из соотношения $R_{{
m NO}_2}=R_{E=0}-R_{{
m I}_2}$. Значение $R_{{
m I}_2}$ измерялось при $P_{NO_2} = 0$.

Влияние вторичных продуктов фотолиза CF_3I на измерения констант скоростей было намного слабее, чем влияние вторичных продуктов фотодиссоциации NO_2 . На основе анализа зависимостей скоростей дезактивации I^* от парциального давления CF_3I константа скорости дезактивации I^* на одном из продуктов реакции CF_3 с NO_2 оценена как 2×10^{-11} см 3 /с. Наиболее вероятно, что этим продуктом является молекула CF_2O [175].

Скорость дезактивации I^* молекулами NO_2 при комнатной температуре не измерялась, поскольку при этой температуре концентрация димеров N_2O_4 относительно высока и затухание излучения атомарного иода определялось, в основном, тушением на димере. При температурах газа $T \geqslant 320~\mathrm{K}$ влиянием N_2O_4 можно пренебречь. Величина константы скорости тушения I^* молекулами NO_2 не зависит от температуры в интервале $320-381~\mathrm{K}$, а ее среднее значение равно $2.9 \times 10^{-15}~\mathrm{cm}^3/\mathrm{c}$ [159].

При комнатной температуре и $P_0 = P_{\text{NO}_2} + P_{\text{N}_2\text{O}_4} \geqslant 2$ Тор тушение I^* молекулами $N_2\text{O}_4$ более эффективно, чем тушение молекулами $N\text{O}_2$. Из анализа зависимостей скоростей релаксации I^* от суммарного давления P_0 бы-

ла найдена константа скорости процесса $N_2O_4 \rightarrow I+$ продукты, которая оказалась равной 3.5×10^{-13} см $^3/c$ [159]. Это почти на два порядка больше константы скорости процесса $I^* + NO_2 \rightarrow I + NO_2$. В этой же работе было найдено, что константа скорости тушения I^* молекулами N_2O не зависит от температуры в интервале 293-378~K и равна 1.4×10^{-15} см $^3/c$. Данное значение хорошо согласуется с полученным при более раннем измерении константы [176].

4. Заключение

Стандартный кинетический пакет для ХКИЛ [11] был предложен более 10 лет назад. За последнее время появились новые кинетические данные и переосмыслены некоторые механизмы образования электронно- и колебательно-возбужденных молекул O_2 и I_2 , которые могут играть важную роль в процессе диссоциации иода. Предложенная недавно [124] многоканальная модель диссошиашии с вовлечением в нее колебательно-возбужденных молекул $O_2(a, v)$ и $I_2(X, v)$ и нижних электронно-возбужденных состояний иода $I_2(A', A)$ обеспечивает наблюдаемые темпы диссоциации иода в реальных смесительных устройствах КИЛ. На данный момент нельзя определенно утверждать, что диссоциация протекает по предложенной схеме, но успешное ее тестирование дает некоторую дополнительную мотивацию для дальнейших исследований и указывает направления решения этой давней проблемы. Для дальнейшего развития предложенной кинетической схемы диссоциации иода необходимы измерения констант скоростей процессов (95) – (103), а также распределений по продуктам энергии, выделяющейся в процессах (1), (3), (5), (9), (33), (44) и (45).

В настоящее время повышенный интерес проявляется к КИЛ, в котором $O_2(a)$ нарабатывается в электроразрядном ГСК. Достоинствами электроразрядного генератора $O_2(a)$ являются нетоксичность исходных газовых компонентов O₂, He, Ar, а также возможность повторного использования реагентов в замкнутом контуре. Низкое давление кислорода и относительно невысокое значение η_{Λ} (15 % – 20 %) на выходе электроразрядного ГСК не позволяют получать приемлемые значения коэффициента усиления в активной среде ЭКИЛ [33]. Увеличение давления кислорода сопровождается ростом скорости тушения $O_2(a)$ [38]. Механизм тушения $O_2(a)$ в присутствии атомов и молекул кислорода до конца не понят. Предложены два возможных канала дезактивации $O_2(a)$. В одном из них синглетный кислород тушится в трехчастичном процессе (2.38) с образованием электронновозбужденного промежуточного комплекса $(O_3)^*$ [38]. В другом предложенном канале синглетный кислород может девозбуждаться в ходе столкновения с колебательновозбужденной молекулой озона $O_3(v)$ [166]. Молекулы $O_3(v)$ в смеси $O-O_2$ образуются в ходе рекомбинации атомов кислорода в процессе $O + O_2 + M \rightarrow O_3(v) + M$. Установление механизма тушения О₂(а) в присутствии атомов и молекул кислорода позволит определить верхний достижимый предел по давлению О2 в электроразрядном ГСК и будет способствовать поиску путей совершенствования электроразрядного КИЛ, потенциал которого раскрыт еще не в полной мере. В недавней работе [177] сообщается о достижении рекордного значения доли синглетного кислорода, $\eta_{\Delta} \approx 45\,\%$, в электроразрядном ГСК. В этой работе был обнаружен эффективный канал образования $O_2(a)$ в ходе гетерогенной рекомбинации атомов кислорода.

Заметим, что процессы образования молекул $O_2(a)$ в реакции (2.5) и их тушения в процессе (2.38)) могут представлять интерес для атмосферной физики. Излучение кислорода на переходе $O_2(a-X)$ в ИК области спектра является одним из самых интенсивных в свечении земной атмосферы [178]. При определенных условиях эти процессы могут заметно влиять на баланс $O_2(a)$ в атмосферах планет. УФ фотолиз N_2O — удобный способ получения синглетного кислорода в лабораторных условиях для изучения кинетики процессов с участием молекул $O_2(a)$, как это было впервые продемонстрировано в [169] при измерении константы скорости процесса (2.12).

5. Литература

- 1. Kasper J.V.V., Pimentel G.C. Appl. Phys. Lett., 5, 231 (1964).
- 2. Devis C.C., Pirkle R.J., McFarlane R.A., Wolga G.J. *IEEE J. Quantum Electron.*, **QE-12**, 334 (1976).
- Ершов Л.С., Залесский В.Ю., Соколов В.Н. Квантовая электроника, 5, 863 (1978).
- Алексеев А.Б., Правилов А.М., Сидоров И.И., Скороходов В.А. Квантовая электроника, 14, 2421 (1987).
- 5. Бредерлов Г., Филл Э., Витте К. *Мощный иодный лазер* (М.: Энергоатомиздат, 1985).
- Хола К., Компа К. В кн. Химические лазеры (М.: Мир, 1980, с. 757).
- Залесский В.Ю., Крупенникова Т.И. Оптика и спектроскопия, 30, 813 (1971).
- McDermott W.E., Pchelkin N.R., Benard D.J., Bousek R.R. Appl. Phys. Lett., 32, 469 (1978).
- 9. Henshaw T.L., Manke II G.C., Madden T.J., Berman M.R, Hager G.D. Chem. Phys. Lett., 325, 537 (2000).
- Manke II G.C., Cooper C.B., Dass S.C., Madden T.J., Hager G.D. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, 5448, 251 (2004).
- 11. Perram G.P. Int. J. Chem. Kinet., 27, 817 (1995).
- 12. Ray A.J., Coombe R.D. J. Phys. Chem., 97, 3475 (1993).
- Henshaw T.L., Herrera S.D., Schlie A.V. J. Phys. Chem., 102, 6239 (1998).
- Дидюков А.И., Краснощеков Ю.И., Кулагин Ю.А., Морозов В.А., Решетняк С.А., Шелепин Л.А. Квантовая электроника, 9, 645 (1982).
- 15. Шинкаренко Н.В., Алесковский В.Б. Успехи химии, 50, 406 (1981).
- Frimer A.A. Singlet O₂ (Boca Raton, Florida: CRC Press Inc., 1985, vol. 1, p. 81).
- Koop G., Hartlove J., Clendening C., et al. AIAA-2000-2421 (Denver, CO, June 19-22, 2000).
- 18. Slanger T.G. Science, 265, 1817 (1994).
- Atkinson R., Baulch D.L., Cox R.A., Hampson R.F., Kerr J.A., Rossi M.J., Troe J. J. Phys. Chem. Ref. Data, 29, 167 (2000).
- 20. Heaven M.C. Adv. Ser. Phys. Chem., 11, 138 (2001).
- Napartovich A.P., Deryugin A.A., Kochetov I.V. J. Phys. D: Appl. Phys., 34, 1827 (2001).
- Vasiljeva A.N., Klopovskiy K.S., Kovalev A.S., Lopaev D.V., Mankelevich Y.A., Popov N.A., Rakhimov A.T., Rakhimova T.V. J. Phys. D: Appl. Phys., 37, 2455 (2004).
- 23. Старик А.М., Луховицкий Б.И., Титова Н.С. Физика горения и взрыва, **44**, 3 (2008).
- Hatz S., Poulsen L., Ogilby P.R. Photochem. Photobiol., 84, 1284 (2008).
- Niedre M.J., Secord A.J., Patterson M.S., Wilson B.C. Cancer Research, 63, 7986 (2003).
- Arnold S.J., Finlayson N., Ogryzlo E.A. J. Chem. Phys., 44, 2529 (1966).
- Derwent R.G., Kearns D.R., Thrush B.A. Chem. Phys. Lett., 6, 115 (1970).
- 28. Derwent R.G., Thrush B.A. J. Chem. Soc. Far. Trans., 68, 720 (1972).
- 29. Derwent R.G., Thrush B.A. Far. Discuss. Chem. Soc., 53, 162 (1972).
- 30. Золотарев В.А., Ишков Д.В., Подмарьков Ю.П., Фролов М.П., Юрышев Н.Н. *Квантовая электроника*, **18**, 912 (1991).

- Ionin A.A., Klimachev Yu.M., Kotkov A.A., Kochetov I.V., Napartovich A.P., Seleznev L.V., Sinitsyn D.V., Hager G.D. J. Phys. D: Appl. Phys., 36, 982 (2003).
- Braginsky O.V., Vasiljeva A.N., Klopovskiy K.S., Kovalev A.S., Lopaev D.V., Proshina O.V., Rakhimov A.T., Rakhimova T.V. J. Phys. D: Appl. Phys., 38, 3609 (2005).
- Carroll D.L., Verdeyen J.T., King D.M., Zimmerman J.W., Laystrom J.K., Woodard B.S., Benavides G.F., Kittell K.W., Solomon W.C. IEEE J. Quantum Electron., 41, 213 (2005).
- Carroll D.L., Verdeyen J.T., King D.M., et al. Appl. Phys. Lett., 86, 111104 (2005).
- Rawlins W.T., Lee S., Kessler W.J., Davis S.J. App. Phys. Lett., 86, 051105 (2005).
- Carroll D.L., Verdeyen J.T., King D.M., et al. *IEEE J. Quantum Electron.*, 41, 1309 (2005).
- Proshina O.V., Rakhimova T.V., Braginsky O.V., Kovalev A.S., Lopaev D.V., Mankelevich Yu.A., Rakhimov A.T., Vasilieva A.N. J. Phys. D: Appl. Phys., 39, 5191 (2006).
- Braginsky O.V., Kovalev A.S., Lopaev D.V., Mankelevich Yu.A., Proshina O.V., Rakhimova T.V., Rakhimov A.T., Vasilieva A.N. J. Phys. D: Appl. Phys., 39, 5183 (2006).
- Ionin A.A., Napartovich A.P., Yuryshev N.N. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, 4631, 284 (2002).
- Hicks A., Tirupathi S., Jiang N., Utkin Yu., Lempert W.R., Rich J.W., Adamovich I.V. J. Phys. D: Appl. Phys., 40, 1408 (2007).
- 41. Savin Yu.V., Goryachev L.V., Adamenkov Yu.A., et al. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, **37**, 3121 (2004).
- Азязов В.Н., Загидуллин М.В., Николаев В.Д., Уфимцев Н.И. Журн. физич. химии, 72, 1850 (1998).
- Pritt A.T., Coombe R.D., Pilipovich D., Wagner R.I., Benard D., Dymec C. Appl. Phys. Lett., 31, 745 (1977).
- Басов Н.Г., Загидуллин М.В., Игошин В.И., Катулин В.А., Куприянов Н.Л. Труды ФИАН, 171, 30 (1986).
- Storch D.J., Dymec C.J., Davis L.P. J. Amer. Chem. Soc., 105, 1765 (1983).
- 46. Юрышев Н.Н. Квантовая электроника, 23, 583 (1996).
- 47. Загидуллин М.В., Николаев В.Д. Изв. РАН. Сер. физич., **63**, 1901 (1999)
- 48. Barmashenko B.D., Rosenwaks S. *J. Appl. Phys.*, **73**, 1598 (1993).
- 49. Азязов В.Н., Куприянов Н.Л. *Труды ФИАН*, **194**, 148 (1989).
- Azyazov V.N., Kupriyanov N.L. J. Russian Laser Research, 15, 243 (1994).
- Басов Н.Г., Вагин Н.П., Крюков П.Г., Нурлигареев Д.Х., Пазюк В.С., Юрышев Н.Н. Квантовая электроника, 11, 1893 (1984).
- Rybalkin V., Katz A., Waichman K., Vingurt D., Dahan Z., Barmashenko B.D., Rosenwaks S. Appl. Phys. Lett., 89, 021115 (2006).
- 53. Fisk G.A., Hays G.N. J. Chem. Phys., 77, 4965 (1982).
- Дидюков А.И., Кулагин Ю.А., Шелепин Л.А., Ярыгина В.Н. Квантовая электроника, 16, 892 (1989).
- Lilenfeld H.V. Final Report of McDonnell Douglas Research Laboratories AFWL-TR-83-1 (May, 1983).
- Marter T., Heaven M.C., Plummer D. Chem. Phys. Lett., 260, 201 (1996).
- 57. Burde D.H., McFarlane R.A. J. Chem. Phys., 64, 1850 (1976).
- 58. Derwent R.G., Thrush B.A. Chem. Phys. Lett., 9, 591 (1971).
- 59. Burrows M.D. J. Chem. Phys., 81, 3546 (1984).
- 60. Young A.T., Houston P.L. J. Chem. Phys., 78, 2317 (1983).
- Burde D.H., Yang T.T., McFarlane R.A. Chem. Phys. Lett., 205, 69 (1993).
- Kaledin A.L., Heaven M.C., Morokuma K. J. Chem. Phys., 114, 215 (2001).
- Heidner R.F., Gardner C.E., El-Sayed T.M., Segal G.I., Kasper J.V.V. J. Chem. Phys., 74, 5618 (1981).
- 64. Cline J.I., Leone S.R. J. Phys. Chem., 95, 2917 (1991).
- Lilenfeld H.V., Whitefield P.D., Bradburn G.R. J. Phys. Chem., 88, 6158 (1984).
- Lilenfeld H.V., Carr P.A.G., Hovis F.E. J. Chem. Phys., 81, 5730 (1984).
- Aviles R.G., Muller D.F., Houston P.L. Appl. Phys. Lett., 37, 358 (1980).
- Heaven M.C., Komissarov A.V., Goncharov V. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, 4631, 13 (2002).

- 1006
- Han J., Komissarov A.V., Tinney S.P., Heaven M.C. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, 5777, 198 (2005).
- Heidner R.F., Gardner C.E., Segal G.I., El-Sayed T.M. J. Phys. Chem., 87, 2348 (1983).
- 71. Komissarov A.V., Heaven M.C. J. Phys. Chem. A, 107, 10527 (2003).
- 72. Palla A.D., Carroll D.L., Verdeyen J.T., Solomon W.C. *AIAA-2005-4919* (Toronto, June 6 9, 2005).
- Вагин Н.П., Золотарев В.А., Крюков П.Г., Пазюк В.С., Подмарьков Ю.П., Фролов М.П., Юрышев Н.Н. Квантовая электроника, 18, 33 (1991).
- Muller D.F., Young R.H., Houston P.L., Wiesenfeld J.R. Appl. Phys. Lett., 38, 404 (1981).
- Heaven M.C., Han J., Davis S.J., Lee S. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, 5334, 53 (2004).
- Бирюков А.С., Щеглов В.А. Квантовая электроника, 13, 510 (1986).
- Antonov I.O., Azyazov V.N., Ufimtsev N.I. J. Chem. Phys., 119, 10638 (2003).
- Antonov I.O., Azyazov V.N., Pichugin S.Yu., Ufimtsev N.I. Chem. Phys. Lett., 376, 168 (2003).
- Азязов В.Н., Сафонов В.С., Уфимцев Н.И. Квантовая электроника, 30, 687 (2000).
- Азязов В.Н., Антонов И.О., Пичугин С.Ю., Сафонов В.С., Свистун М.И., Уфимцев Н.И. Квантовая электроника, 33, 811 (2003)
- Загидуллин М.В., Игошин В.И., Катулин В.А., Куприянов Н.Л. Квантовая электроника, 11, 382 (1984).
- Вагин Н.П., Ионин А.А., Климачев Ю.М. и др. Квантовая электроника, 34, 865 (2004).
- 83. Азязов В.Н. Квантовая электроника, 21, 25 (1994).
- Zimmerman J.W., King D.M., Palla A.D., et al. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, 6261, 62611R (2006).
- Hays G.N., Fisk G.A. IEEE J. Quantum Electron., QE-17, 1823 (1981).
- 86. Бытева Н.М., Черников В.С. Журн. физич. химии, 68, 1208 (1989).
- 87. Rodgers M.A., Snowden P.T. J. Am. Chem. Soc., 104, 5541 (1982).
- Benard D.J., McDermott W.E., Pchelkin N.R., Bousek R.R. Appl. Phys. Lett., 34, 40 (1979).
- 89. Bachar J., Rosenwaks S. Appl. Phys. Lett., 41, 16 (1982).
- Watanabe K., Kashiwabara S., Sawai K., Toshima S., Fujimoto R. J.Appl. Phys., 54, 1228 (1983).
- 91. Вагин Н.П., Коношенко А.Ф., Крюков П.Г., Нурлигареев Д.Х., Пазюк В.С., Томашев В.Н., Юрышев Н.Н. *Квантовая электроника*, **11**, 1688 (1984).
- Richardson R.J., Wiswall C.E., Carr P.A.G., Hovis F.E., Lilenfeld H.V. J. Appl. Phys., 52, 4962 (1981).
- Avizonis P.V., Hasen G., Truesdell K.A. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, 1225, 448 (1990).
- 94. Юрышев Н.Н. Квантовая электроника, 25, 410 (1998).
- 95. Вагин Н.П., Крюков П.Г., Нурлигареев Д.Х., Пазюк В.С., Юрышев Н.Н. *Кр. сообщ. физ. ФИАН*, № 5, 47 (1987).
- 96. Балан Н.Ф., Гизатуллин Р.М., Загидуллин М.В. и др. *Кр. сообщ. физ. ФИАН*, № 4, 23 (1989).
- Азязов В.Н., Загидуллин М.В., Николаев В.Д., Сафонов В.С. Квантовая электроника, 24, 491 (1997).
- 98. Загидуллин М.В., Николаев В.Д., Свистун М.И. *Квантовая* электроника, **21**, 23 (1994).
- Азязов В.Н., Загидуллин М.В., Николаев В.Д., Свистун М.И., Хватов Н.А. Квантовая электроника, 22, 443 (1995).
- 100. Азязов В.Н., Загидуллин М.В., Николаев В.Д., Свистун М.И., Хватов Н.А. Квантовая электроника, 21, 129 (1994).
- 101. Борейшо А.С., Мальков В.М., Савин А.В., Васильев Д.Н., Евдокимов И.М., Трилис А.В., Страхов С.Ю. Квантовая электроника, 33, 307 (2003).
- 102. Адаменков А.А., Бакшин В.В., Богачев А.В. и др. *Квантовая* электроника, **37**, 601 (2007).
- 103.Загидуллин М.В., Николаев В.Д., Свистун М.И., Хватов Н.А. Квантовая электроника, 35, 907 (2005).
- 104.Загидуллин М.В., Николаев В.Д., Свистун М.И., Хватов Н.А. Квантовая электроника, 38, 794 (2008).
- 105. Вагин Н.Н., Пазюк В.С., Юрышев Н.Н. Квантовая электроника, **22.** 776 (1995).
- 106. Rybalkin V., Katz A., Barmashenko B.D., Rosenwaks S. Appl. Phys.

- Lett., 85, 5851 (2004).
- 107. Davis S.J. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 4631, 60 (2002).
- 108. Jirásek V., Špalek O., Kodymová J., Čensky M. Chem. Phys., 269, 167 (2001).
- 109. Katz A., Dahan Z., Rybalkin V., Waichman K., Barmashenko B.D., Rosenwaks S. Appl. Phys. Lett., 90, 161122 (2007).
- 110.Шепеленко А.А., Михеев П.А. Квантовая электроника, **33**, 215 (2003).
- 111. Михеев П.А., Шепеленко А.А., Купряев Н.В. ТВТ, 40, 34 (2002).
- 112. Азязов В.Н., Воробьев М.В., Воронов А.И., Купряев Н.В., Михеев П.А., Уфимцев Н.И. *Квантовая электроника*, **39**, 84 (2009).
- 113. Mikheyev P.A., Azyazov V.N. J. Appl. Phys., 104, 123111 (2008).
- 114. Deakin J.J., Husain D. J. Chem. Soc. Farad. Tran. Pt. II, 68, 1603 (1972).
- 115. Schurath U. J. Photochem., 4, 215 (1975).
- 116. Thomas R.G.O., Thrush B.A. Proc. R. Soc. Lond. A., 356, 295 (1977).
- 117. Grimley A.J., Houston P.L. J. Chem. Phys., 69, 2339 (1978).
- 118. Van Benthem M.H., Davis S.J. J. Phys. Chem., 90, 902 (1986).
- 119. Hall G.E., Marinelli W.J., Houston P.L. J. Phys. Chem., 87, 2153 (1983).
- 120. Barnault B., Bouvier A.J., Pigache D., Bacis R. *J. Physique IV*, **1**, C7-647 (1991).
- 121. Browne R.J., Ogryzlo E.A. Proc. Chem. Soc., 117, 89 (1964).
- 122. Азязов В.Н., Николаев В.Д., Свистун М.И., Уфимцев Н.И. *Квантовая электроника*, **28**, 212 (1999).
- 123. Boodaghians R., Borrell P.M., Borrell P., Grant K.R. J. Chem. Soc. Faraday Trans., 78, 1195 (1982).
- 124. Azyazov V.N., Pichugin S.Yu., Heaven M.C. J. Chem. Phys., 130, 104306 (2009).
- 125.Bloemink H.I., Copeland R.A., Slanger T.G. J. Chem. Phys., 109, 4237 (1998).
- 126. Kalogerakis K.S., Copeland R.A., Slanger T.G. J. Chem. Phys., 116, 4877 (2002).
- 127. Saran D.V., Pejakovic D.A., Copeland R.A. *AGU Fall Meeting* (San Francisco, 2008, SA31A-1601).
- 128. Coletti C., Billing G.D. Chem. Phys. Lett., 356, 14 (2002).
- 129. Kalogerakis K.S., Copeland R.A., Slanger T.G. J. Chem. Phys., 123, 044309 (2005).
- 130. Гордиец Б.Ф., Осипов А.И., Шелепин Л.А. Кинетические процессы в газах и молекулярные лазеры (М.: Наука, 1980).
- 131.Lopez-Puertas M., Zaragoza G., Kerridge B.J., Taylor F.W. J. Geophys. Res., 100, 9131 (1995).
- 132. Huestis D.L. J. Phys. Chem. A, 110, 6638 (2006).
- 133. Азязов В.Н., Пичугин С.Ю., Сафонов В.С., Уфимцев Н.И. Квантовая электроника, **31**, 794 (2001).
- 134. Азязов В.Н., Антонов И.О., Пичугин С.Ю., Уфимцев Н.И. Квантовая электроника, **34**, 1116 (2004).
- 135. Azyazov V.N., Heaven M.C. AIAA J., 44, 1593 (2006).
- 136. Azyazov V.N., Mikheyev P.A., Ufimtsev N.I., Fomin E.V., Antonov I.O., Heaven M.C. *J. Appl. Phys.*, **102**, 123108 (2007).
- 137. Азязов В.Н., Игошин В.И., Куприянов Н.Л. *Кр. сообщ. физ.* Φ *ИАН*, № 1-2, 24 (1992).
- 138.Lawrence W.G., Van Marter T.A., Nowlin M.L., Heaven M.C. *J. Chem. Phys.*, **106**, 127 (1997).
- 139. Азязов В.Н., Пичугин С.Ю. Квантовая электроника, 38, 1101 (2008).
- 140.Пичугин С.Ю. Квантовая электроника, 38, 736 (2008).
- 141. Tellinghuisen J., Phillips L.F. J. Phys. Chem., 90, 5108 (1986).
- 142. Komissarov A.V., Goncharov V., Heaven M.C. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 4184, 7 (2001).
- 143. Macler M, Nicolai J.P., Heaven M.C. J. Chem. Phys., 91, 674 (1989).
- 144. Waichman K., Rybalkin V., Katz A., Dahan Z., Barmashenko B.D., Rosenwaks S. J. Appl. Phys., 102, 013108 (2007).
- 145. David D. Chem. Phys. Lett., 93, 16 (1982).
- 146. Nota M., Bouvier A.J., Bacis R., Bouvier A., Crozet P., Churassy S., Koffend J.B. *J. Chem. Phys.*, **91**, 1938 (1989).
- 147. Brami-Rosilio I., Waichman K., Barmashenko B.D., Rosenwaks S. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, **7131**, 7131OD (2008).
- 148. Schmiedberger J., Fujii H. Appl. Phys. Lett., 78, 2649 (2001).
- 149.Шепеленко А.А., Михеев П.А., Купряев Н.В., Воронов А.И. *Изв. РАН. Сер. физич.*, **64**, 1259 (2000).
- 150.Ionin A.A., Kochetov I.V., Napartovich A.P., Yuryshev N.N. J.

- Phys. D: Appl. Phys., 40, R25 (2007).
- 151. Hill A.E. Appl. Phys. Lett., 91, 041116 (2007).
- 152. Carroll D.L., Benavides G.F., Zimmerman J.W., Woodard B.S., Palla A.D., Verdeyen J.T., Solomon W.C. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, 7131, 71310B (2009).
- 153. Дидюков А.И., Краснощеков Ю.И., Кулагин Ю.А., Морозов В.А., Решетняк С.А., Шелепин Л.А. *Квантовая электроника*, **9**, 731 (1982).
- 154. Золотарев В.А., Крюков П.Г., Подмарьков Ю.П., Фролов М.П., Юрышев Н.Н. *Квантовая электроника*, **16**, 1095 (1989).
- 155. Jones I.T.N., Wayne R.P. Proc. Roy. Soc. Lond. A, 321, 409 (1971).
- 156. Felder P. Chem. Phys., 155, 435 (1991).
- 157. Atkinson R., Baulch D.L., Cox R.A., Crowley J.N., Hampson R.F., Hynes R.G., Jenkin M.E., Rossi M.J., Troe J. http://www.iupac-kinetic.ch.cam.ac.uk, 2006.
- 158. Azyazov V.N., Antonov I.O., Heaven M.C. J. Phys. Chem. A, 111, 3010 (2007).
- 159.Kabir M.H., Azyazov V.N., Heaven M.C. J. Phys. Chem. A, 111, 10062 (2007).
- 160. Payne W.A., Thorn R.P., Nesbitt F.L., Stief L.J. J. Phys. Chem. A, 102, 6247 (1998).
- 161. Atkinson R., Baulch D.L., Cox R.A., Hampson R.F., Kerr J.A., Rossi M.J., Troe J. J. Phys. Chem. Ref. Data, 26, 1329 (1997).
- 162. Вагин Н.П., Золотарев В.А., Крюков П.Г., Пазюк В.С., Подмарьков Ю.П., Фролов М.П., Юрышев Н.Н. *Квантовая электро*-

- ника, 18, 33 (1991).
- 163. Azyazov V.N., Kabir M.H., Heaven M.C. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 6454, 64540K (2007).
- 164. Kaufman F., Kelso J.R. J. Chem. Phys., 46, 4541 (1967).
- 165.Kurylo M.J., Braun W., Kaldor A., Freund S.M., Wayne R.P. J. Photochem., 3, 71 (1974).
- 166. Клоповский К.С., Ковалев А.С., Лопаев Д.В., Рахимов А.Т., Рахимова Т.В. Физика плазмы, **18**, 1606 (1992).
- 167.Окабе Х. Фотохимия малых молекул (М.: Мир, 1981).
- 168. Gonzales M., Valero R., Anglada J.M., Sayos R. J. Chem. Phys., 115, 7015 (2001).
- 169.Azyazov V.N., Kabir M.H., Antonov I.O., Heaven M.C. J. Phys. Chem. A, 111, 6592(2007).
- 170.Sun F., Glass G.P., Curl R.F. Chem. Phys. Lett., 337, 72 (2001).
- 171.Bloss W.J., Rowley D.M., Cox R.A., Jones R.L. *J. Phys. Chem. A*, **105**, 7840 (2001).
- 172. Vöhringer C.M., Badini R.G., Argüello G.A., Staricco E.H. Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 94, 1387 (1990).
- 173. Tellinghuisen J. J. Chem. Phys., 58, 2821 (1973).
- 174. Han J., Komissarov A.V., Tinney S.P., Heaven M.C. *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*, **4971**, 45 (2003).
- 175.Oum K.W., Hancock G. J. Phys. Chem. A, 101, 2634 (1997).
- 176. Hathorn F.G. M., Husain D. Trans. Faraday Soc., 65, 2678 (1969).
- 177. Lee S., Rawlins W. T., Davis S.J. Chem. Phys. Lett., 469, 68 (2009).
- 178. Wayne R.P. J. Photochem., 25, 49 (1984).